



(11) **EP 1 292 176 B1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
09.12.2009 Patentblatt 2009/50

(51) Int Cl.:
H05H 1/30 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **02019754.7**

(22) Anmeldetag: **04.09.2002**

(54) **Vorrichtung zum Erzeugen eines Aktivgasstrahls**

Device for the production of an active gas beam

Dispositif de production d'un jet de gas actif

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR**

(30) Priorität: **07.09.2001 DE 10145131**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.03.2003 Patentblatt 2003/11

(73) Patentinhaber: **TePla AG**
85622 Feldkirchen (DE)

(72) Erfinder:
• **Konavko, Rudolph**
85622 Feldkirchen (DE)
• **Konavko, Arkady**
85748 Garching (DE)

• **Schmid, Hermann**
85591 Vaterstetten (DE)

(74) Vertreter: **Freitag, Joachim et al**
Patentanwälte
Oehmke & Kollegen
Neugasse 13
07743 Jena (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 851 040 DE-A1- 10 115 241
DE-A1- 10 303 402 DE-U1- 29 919 142
US-A- 3 042 830 US-A- 3 239 130
US-A- 3 264 508 US-A- 4 140 892
US-A- 4 916 273

EP 1 292 176 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Erzeugen eines chemisch aktiven Strahls (nachfolgend als Aktivgasstrahl bezeichnet) mittels eines elektrisch generierten Plasmas in einem verwendeten Prozessgas. Die Erfindung eignet sich insbesondere für die Behandlung von Oberflächen, z.B. zur Vorbehandlung und Reinigung von Oberflächen vor dem Verkleben, Beschichten oder Lackieren, zum Beschichten, Hydrophilisieren, Entfernen von elektrischen Ladungen oder Sterilisieren sowie zur Beschleunigung von chemischen Reaktionen.

[0002] Bekannt sind Vorrichtungen zur Oberflächenvorbehandlung von Werkstücken mittels eines in einer elektrischen Entladungszone aktivierten Gases, dargestellt in den Druckschriften DE 195 46 930 C1, DE 195 32 412 A1 und EP 03 05 241. Im Patent DE 195 46 930 C1 wird eine Wirbelströmung des zu aktivierenden Gases durch eine elektrische Entladungszone geführt, die sich zwischen einer kegelförmigen Zentralelektrode und einer am Ende einer Düse außen befindlichen Ringelektrode ausbildet.

Eine weitere Vorrichtung ist in der DE 2 991 9142 beschrieben, wobei im Auslass des Plasmadüsekanals, ein rohrförmiges Mundstück aus elektrisch isolierendem Material eingesetzt ist.

Ein weiteres gleichartiges Verfahren ist in der DE 195 32 412 A1 beschrieben, bei dem das zu aktivierende Gas in einer Wirbelströmung zuerst in den Bereich einer Entladungszone, die entlang der Achse eines zylindrischen Düsenrohres mit innen isolierter zylindrischer Außenelektrode und koaxialer Zentralelektrode entsteht, eingeleitet sowie aktiviert wird und am Ausgang der Entladungszone, an dem das Düsenrohr in Form einer ringförmigen Abschlussfläche der zylindrischen Außenelektrode verengt ist, der Gasstrahl an der Abschlussfläche der Außenelektrode im Wesentlichen entladen wird. Nachteilig an den vorgenannten Lösungen ist, dass der aus der Düse austretende Gasstrahl ein erhebliches elektrisches Potential besitzt, dessen Wert zwischen dem Potential der geerdeten Ringelektrode und dem der Zentralelektrode liegt. Bei entsprechend großem Gasdurchsatz durch die Austrittsöffnung des Gasstromes wölben sich zusätzlich Entladungsbüschel aus der Düse in Richtung des Aktivgasstrahles aus. Der genannte Nachteil begrenzt die Anwendungsmöglichkeiten der beiden vorgenannten Lösungen a) wegen der Stromschlaggefahr für das Bedienpersonal und b) wegen einer möglichen induzierten Defektbildung durch elektromagnetische Felder bei einer Oberflächenbehandlung von empfindlichen Materialien, wie z.B. Halbleitersubstraten, ggf. auch mit dotierten Schichten oder Strukturen.

[0003] Gemäß EP 03 05 241 wird das zu aktivierende Gas direkt durch eine elektrische Entladungszone geführt. Die Entladungszone bildet sich hierbei in einem Rohr mittels eines elektrischen Feldes aus, wobei entweder Elektroden in Strömungsrichtung des Gases nacheinander seitlich innerhalb des Rohres angeordnet

sind oder eine in einem Wellenleiter installierte Entladungskammer aus Isoliermaterial ohne Elektroden vorgesehen ist. Diese Lösung hat den bereits oben angeführten Nachteil, dass bei hoher Geschwindigkeit des aktivierten Gasstromes eine hohe Wahrscheinlichkeit des Austretens von elektromagnetischen Feldern sowie der elektrischen Entladungszone selbst aus der Entladungskammer in die Richtung des Aktivgasstrahls besteht, da eine abschirmende Ringelektrode am Ende der Entladungskammer völlig fehlt. Die in der EP 0 305 241 A1 beschriebene Anordnung verhindert die Gefährdung des Bedienpersonals durch eine separate, geschlossene Bearbeitungskammer, in der die Oberflächenbehandlung des Materials stattfindet. Die so erschwerten Bedingungen der Materialbearbeitung sind nachteilig und würden bei Weglassen der Schutzkammer zu einer unkontrollierten Änderung der Verfahrensbedingungen und zur Gefährdung des Bedienpersonals führen.

Charakteristisch für alle vorgenannten technischen Lösungen ist, dass die Geschwindigkeit, die Temperatur und die Geometrie des Aktivgasstrahls durch die elektrischen, thermischen und gasdynamischen Bedingungen festgelegt werden, die für das Entstehen bzw. Zünden der elektrischen Entladungszone zur Gasaktivierung notwendig sind. Allerdings erweisen sich die genannten Bedingungen zur Gasaktivierung in einer elektrischen Entladungszone nicht immer als optimale Bedingungen für die Oberflächenbehandlung durch den Aktivgasstrahl. So ist es z.B. sehr problematisch, eine elektrische Entladung bei Atmosphärendruck und den dabei entstehenden Temperaturen von mehr als 5000 K zur Oberflächenbehandlung zu nutzen, da die Mehrzahl der zu bearbeitenden Materialien solchen Temperaturen nicht standhält. Ein weiteres Problem stellen hohe Prozessgasgeschwindigkeiten - z.B. Überschallgeschwindigkeit - für die elektrische Entladungszone dar, da diese unter stark dynamischen Bedingungen nur unter großen Schwierigkeiten aufrechterhalten werden kann. Die erwähnten Anwendungen des Aktivgasstrahles verlangen aber höhere Gasdurchsätze, um die Zeit, innerhalb der der Aktivgasstrahl ausgehend von der Entladungszone die zu bearbeitende Oberfläche erreicht, zu verkürzen, weil damit durch Reduzierung der Rekombinationsvorgänge der Aktivitätsverlust des Gasstrahles wirksam verringert wird.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine neue Möglichkeit zum Erzeugen eines chemisch aktiven Strahls (Aktivgasstrahl) mittels eines durch elektrische Entladung generierten Plasmas in einem verwendeten Prozessgas zu finden, bei der bei erhöhter Prozessgasgeschwindigkeit der Aktivgasstrahl auf der zu bearbeitenden Oberfläche eine hohe chemische Aktivität entfaltet und bereits am Ausgang der Vorrichtung elektrisch neutral ist, so dass er keine Gefährdung für Bedienpersonal, Umgebung und bearbeitete Oberfläche darstellt.

[0005] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei einer Vorrichtung zum Erzeugen eines chemisch aktiven Strahls (Aktivgasstrahls) mittels eines durch elektrische

Entladung generierten Plasmas in einem verwendeten Prozessgas mit einer im Wesentlichen zylindrischen Entladungskammer, die von einem Prozessgas durchströmt wird und in der zur Aktivierung des Prozessgases eine Plasmaerzeugung infolge einer elektrischen Gasentladung vorgesehen ist, einem Gaseinlass zum kontinuierlichen Zuführen des Prozessgases in die Entladungskammer sowie einer Austrittsöffnung zum Ausrichten des Aktivgasstrahles auf eine zu bearbeitende Oberfläche, wobei die Entladungskammer ein konisch verjüngtes Ende zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Aktivgasstrahls aufweist, dem verjüngten Ende der Entladungskammer ein Begrenzungs kanal zur Verhinderung der Ausbreitung der Entladungszone in den freien Raum für die zu bearbeitende Oberfläche nachgeordnet ist, wobei der Begrenzungs kanal im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet und geerdet ist und dessen Länge um den Faktor 5-10 größer als sein Querschnitt ist.

[0006] Vorteilhaft ist zur Aktivierung des Prozessgases eine Bogenentladung vorgesehen, wobei die Entladungskammer eine Zentralelektrode und eine Hohlelektrode, die die Innenwand der Entladungskammer mindestens im Bereich des konisch verjüngten Endes flächig und symmetrisch bedeckt, aufweist. Der Begrenzungs kanal schließt sich vorzugsweise an die Hohlelektrode direkt an.

Die Zentralelektrode ist zweckmäßig stabförmig und im Gaseinlassbereich entlang der Symmetrieachse der Entladungskammer angeordnet.

Die Zentralelektrode kann vorteilhaft, um die Leistung des Aktivgasstrahls durch vergrößerte Elektrodenflächen zu erhöhen, die Form eine Zylinderkappe aufweisen, die eine Zylindermantelfläche geringer Höhe und eine Deckfläche beinhaltet und deren Öffnung koaxial zur Achse der Entladungskammer ausgerichtet und oberhalb des Gaseinlasses der Entladungskammer angeordnet ist.

[0007] Für die Verbesserung der Stabilität der Parameter des Aktivgasstrahles ist es von Vorteil, zur Aktivierung des Prozessgases die Entladungskammer in einem mit Hochfrequenz (Radiofrequenz) erzeugten Induktionsfeld anzuordnen.

Das kann zweckmäßig dadurch geschehen, dass die Entladungskammer (1) mit zwei entlang der Wand der Entladungskammer in Strömungsrichtung des Prozessgases angeordneten Elektroden, die mit Radiofrequenz betrieben werden, versehen ist.

Vorteilhaft kann die Hochfrequenzanregung zur Aktivierung des Prozessgases auch durch die Erzeugung eines Induktionsfeldes erreicht werden, indem die Entladungskammer in einer mit Radiofrequenz betriebenen Spule angeordnet ist.

Eine weitere Möglichkeit zur Aktivierung des Prozessgases ohne Kontaminierung des Aktivgases durch Elektrodenmaterial ist dadurch gegeben, dass die Entladungskammer in einem an einer Mikrowellenquelle angeschlossenen Wellenleiter angeordnet ist.

Zur Formung, Wahl der Strömungsart (laminare oder tur-

bulente Strömung) und Einstellung des Aktivgasstrahls mit gewünschten Parametern, insbesondere Geschwindigkeit, Temperatur, geometrische Form und Strömungsart, ist dem Begrenzungs kanal zweckmäßig eine strahlformende Einrichtung nachgeordnet.

Dabei kann es von Vorteil sein, dass an den Ausgang des Begrenzungs kanals verzweigte Düsen zum Bearbeiten einzelner Teilflächen oder Vertiefungen der zu bearbeitenden Oberfläche angeschlossen sind.

Die strahlformende Einrichtung ist zweckmäßig durch Leitbleche an die Form der zu bearbeitenden Oberfläche angepasst, wobei der Abstand zwischen der Oberfläche und der strahlformenden Einrichtung in einem definiert kleinen Bereich gehalten wird, so dass die effektiv behandelte Oberfläche eine größere Fläche umfasst.

Für spezielle Anwendungen eines Aktivgasstrahles sind strahlformende Einrichtungen vorgesehen, die zwei oder mehrere erfindungsgemäße Vorrichtungen zur Erzeugung des Aktivgasstrahles in einen Bearbeitungskanal einbinden, wobei in dem Bearbeitungskanal bei kontinuierlichem Materialdurchlauf mehrere zu behandelnde Oberflächen eines Werkstücks gleichzeitig oder Oberflächen von Strangprofilen mit beliebigem Querschnitt allseitig bearbeitbar sind.

[0008] Bei Anwendung eines Aktivgasstrahles mit speziellen Zusatzstoffen (insbesondere für die Beschichtung von Oberflächen) ist vorzugsweise in der Entladungskammer axial ein Zufuhrrohr zur Einbringung von Zusatzstoffen angeordnet, das kurz vor dem Ausgang der Entladungskammer endet, wobei ein Einfluss der Zusatzstoffe auf die Entladungscharakteristik und eine Kontaminierung der Entladungskammer (1) durch die Zusatzstoffe oder deren Reaktionsprodukte vermieden wird.

Es erweist sich zur Erzielung einer definierten Gasströmung als vorteilhaft, wenn der Begrenzungs kanal mehrere Einzelkanäle umfasst, um den gasdynamischen Widerstand und die Verweildauer des Aktivgases im Begrenzungs kanal zu reduzieren, wobei die Einzelkanäle um einen zentralen Kanal herum gleichmäßig verteilt angeordnet sind. Dabei gestaltet sich die Zufuhr von Zusatzstoffen besonders günstig, wenn der Begrenzungs kanal mit mehreren Einzelkanälen einen zentralen Einlasskanal für die Zusatzstoffe aufweist, wobei der Einlasskanal axial im Zentrum eines Ringes von mit Aktivgas durchströmten Einzelkanälen angeordnet ist, da eine vorzeitige Reaktion oder ein Zerfall der Zusatzstoffe sowie eine Kontamination der Entladungskammer durch die Zusatzstoffe vermieden werden kann.

Für alle vorgenannten Zufuhrvarianten sind die Zusatzstoffe im Bereich des Begrenzungs kanals vorteilhaft als Gase, Flüssigkeiten in Form von Aerosolen oder Feststoffe in Form feiner Partikel einführbar.

In einer besonders zweckmäßigen Gestaltungsvariante der Erfindung sind die Hohlelektrode, der Begrenzungs kanal und die strahlformende Einrichtung als einheitlicher Rotationskörper mit sehr guter elektrischer Leitfähigkeit gefertigt, die Zentralelektrode koaxial von einem Isolatorrohr umgeben in die von der Hohlelektrode ge-

bildete Entladungskammer eingeführt und der Gaseinlass in die Entladungskammer zunächst einer zylindrischen Verteilungskammer zugeführt, wobei für das Prozessgas tangentiale Strömungskanäle von der Verteilungskammer zur Entladungskammer vorgesehen sind, so dass infolge einer resultierenden spiralförmigen Gasströmung aus der Verteilungskammer in die Entladungskammer Bogenentladungen zwischen Zentralelektrode und Hohlelektrode an einem aus dem Isolatorrohr herausragenden Ende der Zentralelektrode fixiert werden. Hierdurch wird eine Erosion des Isolatorrohres weitgehend verhindert. Vorteilhaft können tangentiale Strömungskanäle zusätzlich in eine zylindrische Ringkammer zwischen stabförmiger Zentralelektrode und innerer Oberfläche des Isolatorrohres geführt sein, so dass die Zentralelektrode direkt von einem Anteil des Prozessgases gekühlt wird und Austrittspunkte von Bogenentladungen im Wesentlichen auf nichtzylindrische Flächen der Zentralelektrode beschränkt sind. Dadurch wird das Isolatorrohr noch wirksamer vor der Erosionswirkung des Entladungsbogens geschützt.

Das Isolatorrohr wird zweckmäßig durch die Zentralelektrode um eine Länge von bis zum Zweifachen des Durchmessers der Zentralelektrode überragt. Verwendet man die zusätzlich Prozessgaszufuhr innerhalb des Isolatorrohres, kann das Ende der Zentralelektrode verkürzt werden und schließt im Extremfall mit dem Ende des Isolatorrohres ab.

Der Begrenzungs kanal ist vorzugsweise in Gasströmungsrichtung leicht kegelförmig verengt und weist ein mittleres Verhältnis von Kanaldurchmesser zu Kanallänge von 1:8 auf. Dem Begrenzungs kanal schließt sich vorteilhaft eine strahlformende Einrichtung mit glockenförmig verbreitertem Ausgang an, so dass die Arbeitsbreite des Aktivgasstrahles vergrößert wird.

[0009] Der Grundgedanke der Erfindung basiert darauf, dass bei den bekannten Vorrichtungen des Standes der Technik mit plasmainduziertem Aktivgasstrahl entweder die Aktivität des Gasstrahles zu gering oder der Aktivgasstrahl bei seinem Austritt in den Bearbeitungsraum noch ein gefährlich hohes elektrisches Potential besitzt, das zu einer Gefährdung des Bedienpersonals führt. Diese einander gegensätzlich beeinflussenden Probleme werden gemäß der Erfindung dadurch beseitigt, dass das Prozessgas der Reihe nach durch drei Zonen geführt wird. Zuerst wird das Prozessgas (im Entladungsraum) aktiviert und beschleunigt, dann in einem engen geerdeten Begrenzungs kanal die geschwindigkeitsbedingte Ausbreitung der Entladungszone aus dem Entladungsraum heraus in den Aktivgasstrahl abgefangen (begrenzt) und zuletzt ein elektrisch neutraler, chemisch wirksamer Aktivgasstrahl durch strahlformende Einrichtungen entsprechend der gewünschten Anwendung (Reinigung, Beschichtung, Aktivierung usw.) geformt wird. Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann dabei mit allen bekannten Methoden der plasmainduzierten Aktivierung von Prozessgasen kombiniert werden, bei denen eine Korona-, Glimmoder Bogenentladungszone

(unter Verwendung eines Gleich-, Wechsel- oder Impulsstromes) oder eine im elektromagnetischen Wechselfeld erzeugte Hochfrequenzentladungszone (mit Anregungsfrequenzen bis in den Mikrowellenbereich), entsteht.

Die Wirksamkeit des Begrenzungs kanals hängt dabei wesentlich davon ab, dass er einen kleineren Durchmesser im Verhältnis zur Entladungskammer aufweist. Deshalb ist die Entladungskammer in Strömungsrichtung des Prozessgases konisch verjüngt, so dass bei großem Verhältnis von Querschnitt der Entladungskammer zu Querschnitt des Begrenzungs kanals die Geschwindigkeit des Aktivgasstrahls wesentlich ansteigt, wodurch die Zeit, die die chemisch aktiven Teilchen des Aktivgasstrahls benötigen, um die Strecke von der Entladungskammer bis zum Anwendungsort zurückzulegen, stark reduziert wird. Infolge der Zeitverkürzung kommt es zu weniger Rekombinationen aktiver Teilchen (verringert Aktivitätsverlust des Aktivgasstrahls) und dies führt zu einer Erhöhung der Effektivität des Aktivgasstrahles auf der zu bearbeitenden Oberfläche. Bei sehr hohem Gasdurchsatz durch die Entladungszone wölben sich Entladungsbüschel aus der Entladungszone in den ausströmenden Aktivgasstrahl aus. Die elektrische Leitfähigkeit und der damit verbundene elektrische Widerstand des Plasmabogens bei gleichzeitig hohem Strom führt zu einem erheblichen Potential gegenüber der geerdeten Elektrode auch in naher Distanz des Plasmabogens der geerdeten Elektrode. Um das Austreten der Entladungsbüschel mit gefährlichem elektrischen Potential in den freien Raum zu verhindern, wird der Aktivgasstrahl am Ausgang der Entladungszone durch einen engen geerdeten Kanal geführt. Der Begrenzungs kanal ist so dimensioniert, dass ein in ihn eintretender Entladungsbogen ein Potential besitzt, dessen Größe am Eintritt in den Begrenzungs kanal für einen Durchbruch zur Kanalwand noch zu gering ist. Mit zunehmender Weglänge im Begrenzungs kanal steigt die Spannung im Entladungsbogen so weit an, bis ein Durchbruch zur Kanalwand erfolgt. Damit muss der Begrenzungs kanal entsprechend den übrigen Bedingungen der Plasmaerzeugung eine Mindestlänge besitzen, die sicherstellt, dass vorgenannte Auswölbungen der Entladungszone in den freien Raum nicht auftreten können. Das geschieht bei einem Verhältnis des Querschnittes zur Kanallänge von 1:5 bis 1:10.

[0010] Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt die Erzeugung eines elektrisch neutralen, chemisch aktiven Strahls, wobei mit erhöhter Prozessgasgeschwindigkeit der Aktivgasstrahl auf der zu bearbeitenden Oberfläche eine hohe chemische Aktivität entfaltet und bereits am Ausgang der Vorrichtung elektrisch neutral ist, so dass er keine Gefährdung für Bedienpersonal, Umgebung und bearbeitete Oberfläche darstellt.

[0011] Die Erfindung soll nachstehend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Die Zeichnungen zeigen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit elektrischer

- Entladung, die durch ein beliebiges elektromagnetisches Feld ausgelöst wird;
- Fig. 2: eine Ausgestaltung der Erfindung mit elektrischer Bogenentladung zwischen stabförmiger Zentralelektrode und Hohlelektrode an der Wand der Entladungskammer sowie mit einem aus mehreren Einzelkanälen bestehenden Begrenzungskanal;
- Fig. 3: eine Gestaltung der Erfindung mit Bogenentladung über eine Zentralelektrode in Form einer Zylinderkappe;
- Fig. 4: eine Gestaltungsform mit einem mittels Innenelektroden erzeugten Hochfrequenzfeld;
- Fig. 5: eine Ausführungsform mit Erzeugung der Gasentladung durch Mikrowellen;
- Fig. 6: eine Gestaltungsform mit einem induktiv erzeugten Hochfrequenzfeld;
- Fig. 7: schematische Darstellung der Erfindung zum Aufteilen des Aktivgasstrahls zur gleichzeitigen Bearbeitung einzelner Teilflächen auf Oberflächen mit kompliziertem Relief;
- Fig. 8: schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung, wobei die strahlformende Einrichtung einer ebenen Oberfläche angepasst ist;
- Fig. 9: schematische Darstellung wie in Fig. 8, wobei die strahlformende Einrichtung einer sphärischen Oberfläche angepasst ist;
- Fig. 10: eine spezielle Ausgestaltung, bei der mehrere erfindungsgemäße Vorrichtungen mit deren strahlformenden Einrichtungen in einen Bearbeitungskanal mit kontinuierlichem Materialfluss eingebunden sind;
- Fig. 11: eine Gestaltungsform zum Zuführen von Zusatzstoffen in den Aktivgasstrahl vor dem Begrenzungskanal;
- Fig. 12: eine Variante zum Zuführen von Zusatzstoffen am Ende des Begrenzungskanals;
- Fig. 13: eine konstruktive Ausführung der Vorrichtung mit spezieller Gestaltung der Strömungskanäle für das zugeführte Prozessgas bei Aktivierung mittels Bogenentladung.

[0012] Die Vorrichtung zur Erzeugung eines Aktivgasstrahles gemäß Fig. 1 besteht in ihrem Grundaufbau aus einer von einem Prozessgas 1 durchströmten Entladungskammer 2, in der eine Aktivierung des Prozessgases 1 in Form einer durch ein starkes Feld 3 erzeugten elektrischen Entladung stattfindet, einem im Wesentlichen zylindrischen Begrenzungskanal 4 und einer Strahlformungseinrichtung 5 für den zur Materialbearbeitung im freien Raum vorgesehenen Aktivgasstrahl 6. Die Entladungskammer 2 weist in Durchströmungsrichtung des Prozessgases 1 ein konisch verjüngtes Ende 21 (d.h. eine düsenähnlich verengte Form) auf, das der

Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit des Prozessgases 1 während seiner Aktivierung in der Entladungskammer 2 dient. Mit dieser Erhöhung der Gasgeschwindigkeit wird die Zeitdauer zum Erreichen einer zu bearbeitenden Oberfläche 7 (nur in Fig. 7 bis 9 dargestellt) verkürzt und damit die Rekombination von aktiven Gas-
 5 teilchen vor Erreichen des Bearbeitungsortes vermindert. Gleichzeitig mit der Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit erhöht sich jedoch die Gefahr, dass sich eine in der Entladungskammer 2 durch die Wirkung des
 10 Feldes 3 ausbildende Entladungszone 22 über das konisch verjüngte Ende 21 der Entladungskammer 2 hinaus nach außerhalb fortsetzt. Um zu verhindern, dass infolge der hohen Gasgeschwindigkeit sogenannte Entladungs-
 15 büschel mit gefährlich hohem elektrischen Potential als Auswölbung 24 der Entladungszone 22 aus der Entladungskammer 1 in den freien Raum austreten, wird der durch das verjüngte Ende 21 beschleunigte Aktivgasstrahl 6 am Ausgang der Entladungskammer 1
 20 durch einen engen, geerdeten Begrenzungskanal 4 geführt. Hierdurch wird wirkungsvoll eine Begrenzung der Ausbreitung der Entladungszone 22 in Richtung der freien Austrittsöffnung des Aktivgasstrahls 6 verhindert. Der Begrenzungskanal 4 ist so dimensioniert, dass der
 25 in ihn eintretende Teil der Entladungszone 22 ein solches Potential erreicht, dessen Größe am Eintritt in den Begrenzungskanal 4 für einen Durchbruch zur Kanalwand noch zu gering ist, jedoch mit zunehmender Weglänge im Begrenzungskanal 4 so weit ansteigt, bis ein Durchbruch zur geerdeten Wand des Begrenzungskanals 4
 30 erfolgt. Des Weiteren muss der Begrenzungskanal 4 entsprechend den übrigen Bedingungen der zur Aktivierung des Prozessgases 1 erforderlichen Plasmaerzeugung eine Mindestlänge besitzen, die sicherstellt, dass vorgenannte Auswölbungen 24 der Entladungszone 22 in den freien
 35 Raum nicht geschehen können. Dies wird in der Regel mit einem Verhältnis des Kanalquerschnittes zur Kanal-länge von 1:5 bis 1:10 erreicht. Die Wirksamkeit des Aktivgasstrahles 6 hängt aber auch
 40 wesentlich davon ab, dass der Begrenzungskanal 4 einen deutlich kleineren Durchmesser im Verhältnis zum Hauptteil der Entladungskammer 2 (vor deren konisch verjüngtem Ende 21) aufweist, so dass bei großem Verhältnis (1:5 bis 1:8) des Querschnitts der Entladungs-
 45 kammer 2 gegenüber dem Querschnitt des Begrenzungskanals 4 die Geschwindigkeit des Aktivgasstrahls 6 wesentlich ansteigt, wodurch die Zeit, die die chemisch aktiven Teilchen des Aktivgasstrahls 6 benötigen, um die Strecke von der Entladungskammer 2 bis zum Anwen-
 50 dungsort zurückzulegen, stark reduziert wird. Infolge der Zeitverkürzung kommt es zu weniger Rekombinationen aktiver Teilchen (verringertes Aktivitätsverlust des Aktivgasstrahls 6) und dies führt zu einer Erhöhung der Effektivität des Aktivgasstrahles 6 auf der zu bearbeitenden
 55 Oberfläche 7 (in Fig. 1 nicht dargestellt). Andererseits wird dadurch jedoch aufgrund des geringen Durchmessers des Begrenzungskanals 4 der aerodynamische Wi-

derstand am verjüngten Ende 21 der Entladungskammer 2 steigen und die Effektivität innerhalb der Entladungszone 22 beeinträchtigen. Dies erklärt sich dadurch, dass die Temperatur des Plasmas mit steigendem Druck zunimmt. Der Begrenzungskanal 4 ist deshalb im Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet und weist einen auf den Durchmesser der Entladungskammer 2 angepassten Querschnitt von 1:5 bis 1:8 auf.

[0013] In die Entladungskammer 2 wird Prozessgas 1 eingeleitet. Dabei wird das zugeführte Prozessgas 1 durch die Wechselwirkung mit dem Feld 3 in der elektrischen Entladungszone 22 aktiviert, im konisch verjüngten Teil 21 der Entladungskammer 2 beschleunigt und größtenteils entladen und in den Begrenzungskanal 4 eingeleitet, der die Ausbreitung der Entladungszone 22 nach außen in den freien Bearbeitungsraum verhindert. Nach dem Begrenzungskanal 4 strömt der Aktivgasstrahl 6 durch eine strahlformende Einrichtung 5, in der er entsprechend dem Anwendungszweck in bezug auf Geschwindigkeit, Temperatur, geometrische Form und Strömungsart (laminar oder turbulente Strömung) geformt wird. Die Entladungszone 22 kann dabei beliebig (je nach Art der verwendeten Felderzeugung) durch Gleich-, Wechsel- oder Impulsstrom, elektromagnetische Induktion, Mikrowellen oder andere Anregungsarten, die eine elektrische Gasentladung beim verwendeten Prozessgas 1 auslösen, entstehen.

Fig. 2 stellt die Erfindung in einer Variante dar, bei der eine Aktivierung des Prozessgases 1 durch eine Bogenentladung 34 zwischen zwei Elektroden in der Entladungskammer 2 erfolgt. Eine der Elektroden ist eine stabförmige Zentralelektrode 31, die andere befindet sich an der Innenwand der Entladungskammer 2 und bildet eine sogenannte Hohlelektrode 32. Die Hohlelektrode 32 ist mindestens an dem konisch verjüngten Ende 21 der Entladungskammer 2 angebracht. Sie kann aber auch selbst die Wand der Entladungskammer 2 bilden (wie z.B. in Fig. 13 dargestellt).

In die Entladungskammer 2, in der zwischen der Zentralelektrode 31 und der Hohlelektrode 32 entlang der inneren Wand der Entladungskammer 2 mittels eines Generators 33 eine elektrische Bogenentladung 34 stattfindet, wird tangential das Prozessgas 1 eingeleitet.

Durch die Wechselwirkung mit der elektrischen Bogenentladung 34 wird das Prozessgas 1 aktiviert, im kegelförmig verjüngten Teil 21 der Entladungskammer 1 beschleunigt und auf dem Weg zum Begrenzungskanal 4 größtenteils entladen. Im nachfolgenden Begrenzungskanal 4, der eine bei großen Gasgeschwindigkeiten mögliche Auswölbung 23 der Entladungszone 22 aufnimmt, wird eine Weiterleitung des elektrischen Potentials der Entladungszone 22 nach außen in den freien Raum der zu bearbeitenden Oberfläche 7 verhindert. Bei sehr hohem Gasdurchsatz durch die Entladungskammer 2 werden Entladungsbüschel in den Aktivgasstrahl des Begrenzungskanals 4 ausgeblasen, d.h. es bildet sich eine Auswölbung 23 der Entladungszone 22. Die elektrische Leitfähigkeit und der damit verbundene elektrische Wid-

erstand des Plasmabogens (elektrischer Entladungsbogen im Prozessgas 1) bei gleichzeitig hohem Strom führt zu einem erheblichen Potential gegenüber der geerdeten Hohlelektrode 32 auch in naher Distanz des Plasmabogens. Es tritt deshalb auch außerhalb der Entladungskammer 2 ein erhebliches elektrisches Potential auf, wenn mit hoher Prozessgasgeschwindigkeit gearbeitet wird. Dieses Potential kann unter Umständen am kreisringförmigen Ende der Hohlelektrode 32 noch einige Hundert Volt betragen. Diese Erscheinung stellt eine Gefährdung für das Bedienpersonal dar, falls an dieser Stelle der Bearbeitungsraum anschließt. Im Fall des Austretens von Entladungsbüscheln könnten außerdem elektrische Defekte an sensiblen Oberflächen zu behandelnder Objekte - z.B. Halbleiter oder Halbleiterstrukturen - hervorgerufen werden. Um das Austreten der Auswölbungen 23 (Entladungsbüschel) mit gefährlichem elektrischen Potential infolge einer hohen Aktivgasstrahlgeschwindigkeit aus der Entladungszone 22 in den freien Raum zu verhindern, wird der Aktivgasstrahl 6 am Ausgang der Entladungskammer 2 durch den engen, geerdeten Begrenzungskanal 4 geleitet, in dem mit einem gewissen aerodynamischen Stau eine weitere Entladung des Aktivgasstrahles 6 erfolgt. Der Begrenzungskanal 4 ist so dimensioniert, dass die in ihn eintretende Auswölbung 23 der Entladungszone 22 ein Potential besitzt, dessen Größe am Eintritt in den Begrenzungskanal 4 für einen Durchbruch zur Kanalwand noch zu gering ist. Mit zunehmender Weglänge im Begrenzungskanal 4 steigt die Spannung im Entladungsbogen so weit an, bis ein Durchbruch zur Kanalwand erfolgt. Somit muss der Begrenzungskanal 4 entsprechend den übrigen Bedingungen der Plasmaerzeugung eine gewisse Mindestlänge besitzen, die sicherstellt, dass vorgenannte Auswölbung 23 der Entladungszone 22 den Begrenzungskanal 4 nicht durchqueren kann und die mit einem Verhältnis zwischen Kanalquerschnitt und Kanallänge von 1/5 bis 1/10 anzugeben ist. Der Aktivgasstrahl 6 weist eine mit der Temperatur am Ausgang der Entladungskammer 2 vergleichbare Temperatur auf, seine gasdynamischen Eigenschaften (Geschwindigkeit und Strömungsverhältnisse) werden jedoch vom Gasdurchsatz und von den Dimensionen und der konstruktiven Gestaltung des Begrenzungskanals 4 wesentlich mitbestimmt.

Nach dem Begrenzungskanal 4 strömt der Aktivgasstrahl 6 durch die strahlformende Einrichtung 5, in der er entsprechend dem Anwendungszweck in bezug auf Geschwindigkeit, Temperatur, geometrische Form und Strömungsart (laminar oder turbulente Strömung) geformt wird. Hierfür können verschiedene Ausführungen von strahlformenden Einrichtungen 5 zur Anwendung gelangen, z.B. Düsen, derartig gestaltet, dass eine adiabatische Expansion des Aktivgasstrahls auftritt, um die Temperatur zu senken, oder abgeflachte strahlformende Einrichtungen 5, wie sie nachfolgend noch näher beschrieben werden, um einen flachen, breiten Aktivgasstrahl 6 zu formen.

Die elektrische Entladungszone 22 kann für die beschrie-

bene Vorrichtung beliebig (je nach Art des verwendeten Spannungsgenerators 33) durch Gleich-, Wechsel- oder Impulsstrom entstehen.

Der in der Entladungskammer 2 erzeugte Aktivgasstrahl 6 verliert beim Durchströmen des Begrenzungschanals 4 leider auch einen Teil seiner Aktivität infolge von Rekombination der aktiven Teilchen und wegen Wechselwirkungen des Aktivgasstrahles 6 mit der Kanalwand. Um die Wirkung vorgenannter Prozesse zu vermindern, ist bei einer Kürzung der Kanallänge eine gleichzeitige Verkleinerung des Querschnitts des Begrenzungschanals 4 erforderlich. Dadurch würde jedoch der aerodynamische Widerstand des Begrenzungschanals 4 steigen und die Effektivität innerhalb der Entladungskammer 2 beeinträchtigt. Dies erklärt sich dadurch, dass die Temperatur des Plasmas mit steigendem Druck zunimmt. Gleichzeitig wird eine stärkere thermische Belastung der Zentralelektrode 31 und Hohlelektrode 32 verursacht, die zu höherem Elektrodenverschleiß führt. Dies kann dadurch vermindert werden, dass der Begrenzungschanal 4 aus zwei oder mehreren geerdeten Einzelkanälen 41 besteht, die in elektrisch leitendem Material parallel zueinander angeordnet sind und einen größeren effektiven Strömungsquerschnitt ergeben. Fig. 2 zeigt dazu eine Ausführung, bei der um einen zentralen Einzelkanal 41 herum weitere Einzelkanäle 41 gleichmäßig verteilt angeordnet sind.

Fig. 3 stellt eine Erzeugung eines Aktivgasstrahles 6 dar, bei der - im Unterschied zum oben beschriebenen Beispiel - die Zentralelektrode 31 anstatt der Stabform die Form einer elektrisch leitenden Zylinderkappe aufweist. Diese Zentralelektrode 31 ist mit ihrer Öffnung in Richtung der Entladungskammer 2 koaxial angeordnet. Das Prozessgas 1 wird tangential in einen Spalt zwischen der zylindrischen Zentralelektrode 31 und der Entladungskammer 2 eingeleitet. Beim Einsatz einer solchen Form der Zentralelektrode 31 vergrößert sich die Stützfläche der Bogenentladung 34 auf der Zentralelektrode 31, d.h. die Fußpunkte der Bogenentladungen 34 bewegen sich bei intensiv verwirbelter Strömung des Prozessgases 1 auf einer größeren Oberfläche. Dadurch wird bei der Zentralelektrode 31 eine Überhitzung verhindert und die Lebensdauer sowie der maximale Entladungsstrom erhöht.

In Fig. 4 ist eine Variante dargestellt, bei der das Prozessgas 1 zwischen zwei in der Entladungskammer 2 in Strömungsrichtung nacheinander angeordneten Elektroden 35 aktiviert wird. Mittels eines Hochfrequenzgenerators 36 wird die Entladungszone 22 durch eine Hochfrequenzentladung in einem Wechselfeld 3 erzeugt, wobei die Entladungskammer 2 aus elektrisch isolierendem Material (z.B. Quarz) besteht.

Da hinlänglich bekannt ist, dass die bei Verwendung von kalten Elektroden 35 entstehende elektrische Entladung unter bestimmten Drücken, z.B. bei Atmosphärendruck, ohne zusätzliche Maßnahmen instabil ist, weil hohe Elektronendichten und Energiegradienten vor den Elektroden 35 eine Raumladungsschicht erzeugen und die En-

tladung destabilisieren. In Hochfrequenzentladungen wird diese Stabilisierung durch einfache Maßnahmen (wie sie beispielsweise von J. Reece Roth in: Industrial Plasma Engineering, Vol. 1: Principles, Inst. of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 1995, S. 382-385, 404-407, 464f. beschrieben sind) erzielt. Aus diesem Grund der einfachen Erhaltung einer stabilen Entladung ist eine HF-Entladung zur Aktivierung des Prozessgases 1 besonders vorteilhaft.

Sämtliche Elektroden, wie sie in den vorhergehenden Gestaltungsvarianten zur Erzeugung der elektrischen Entladungszone 22 beschrieben wurden, sind jedoch mehr oder weniger einem Erosionsprozess ausgesetzt, d.h. sie verschleissen. Das führt zu einer Kontamination der Entladungskammer 2 und des Prozessgases 1 durch Elektrodenmaterial. Um einen von Kontamination durch Elektrodenmaterial freien Aktivgasstrahl 6 zu erzeugen, wird gemäß Fig. 5 die Entladungszone 22 ohne Elektroden erzeugt. Dazu wird die in diesem Beispiel aus elektrisch isolierendem, aber mikrowellentransparentem Material bestehende Entladungskammer 2 in das Feld 3 eines Mikrowellengenerators 37 eingebracht, wobei in einem typischen Mikrowellenleiter 38, der an den Mikrowellengenerator 37 angeschlossen ist, ein Ort relativ gleichmäßiger und hoher Feldstärke genutzt wird. Alle übrigen Abläufe, die aus der Entladungszone 22 den Aktivgasstrahl 6 hervorbringen, laufen entsprechend den vorhergehenden Beispielen ab.

Eine ebenfalls elektrodenlose Aktivierung des Prozessgases 1 ist in Fig. 6 dargestellt. Hier wird ein Hochfrequenzgenerator 36 dazu benutzt, mit einer Spule 39 ein hochfrequent wechselndes Feld 3 in der Entladungskammer 2 zu induzieren. Dabei ist die Entladungskammer 2 innerhalb der Windungen der Spule 39 angeordnet und bildet innen die gewünschte Entladungszone 22 aus. Das Material der Entladungskammer 2 ist relativ frei wählbar, jedoch notwendig nicht ferromagnetisch. Wie bereits in den vorherigen Beispielen beschrieben, wird das Prozessgas 1 im konisch verjüngten Ende 21 der Entladungskammer 2 beschleunigt und im geerdeten Begrenzungschanal 4 von seinem gefährlichen Potential befreit, so dass am Ausgang der strahlformenden Einrichtung 5 ein elektrisch neutraler Aktivgasstrahl 6 zur Verfügung steht.

[0014] Bei anspruchsvollen Oberflächenbehandlungen ist es häufig erforderlich, einzelne Teile von Oberflächen 7 oder Vertiefungen an Werkstücken gleichwertig zu bearbeiten. Dazu wird der ursprünglich einheitliche Aktivgasstrahl 6 für die Bearbeitung von einzelnen Flächenteilen 71 und Vertiefungen in mehrere Strahlen aufgeteilt. Fig. 7 zeigt dazu eine stilisierte Entladungskammer 2, bei der die Art der Erzeugung der elektrischen Entladung beliebig gewählt sein kann. Das erzeugte Aktivgas wird aus der Entladungskammer 2 durch den Begrenzungschanal 4 in eine strahlformende Einrichtung 5 geleitet, die verzweigte Düsen 51 aufweist. Die verzweigten Düsen 51 sind dabei auf unterschiedliche Teilflächen 71 gerichtet, die unterschiedliche Höhen in der zu bearbeitenden Oberfläche 7 darstellen und jeweils einen An-

teil des Aktivgasstrahles 6 auf die Teilflächen 71 leiten.

[0015] Bei den zur Oberflächenbearbeitung bekannten Plasmastrahl-Generatoren, wie z.B. nach DE 195 46 930 C1, DE 195 32 412 A1, wird der Gasstrahl nach dem Verlassen des Generators verbreitert, bevor er die zu bearbeitende Oberfläche erreicht. Geschieht das allerdings zu großzügig, verliert der Gasstrahl auf dem Weg zur Oberfläche 7 zuviel Aktivität durch Rekombinationen sowie Wechselwirkungen mit den Gasteilchen der umgebenden Atmosphäre. Zu der vorliegenden Erfindung werden deshalb einige zusätzliche Maßnahmen vorgeschlagen, die die Aktivitätsverluste auf dem Weg von der Erzeugung des Aktivgasstrahles 6 bis zum Erreichen der zu bearbeitenden Oberfläche 7 auch bei einer großen gleichzeitig bearbeiteten Oberfläche 7 gering halten. Dazu zeigen die Figuren 8 und 9 zwei Möglichkeiten für regelmäßig geformte Oberflächen 7. In Fig. 8 sind als strahlformende Einrichtung 5, direkt an den Begrenzungskanal 4 anschließend, abgewinkelte, weitgehend ebene Leitbleche 52 vorgesehen, die in geringem Abstand über der ebenen Oberfläche 7 gleichmäßig geführt werden müssen. Durch diese Maßnahme wird die bereits in der am Ende verjüngten Entladungskammer 2 erzeugte und über den Begrenzungskanal 4 weitergeleitete hohe Gasgeschwindigkeit auch in der strahlformenden Einrichtung 5 in Form eines Strahls, der parallel zur Oberfläche 7 geführt wird, durch eine Art Grenzschiebung fortgesetzt. Chemisch aktive Teilchen des Aktivgasstrahles 6, der hierbei zu einer nahezu laminaren Strömung entartet, kommen somit in kürzester Zeit auf eine größere Fläche der zu bearbeitenden Oberfläche 7, noch bevor sie rekombinieren können. Dieselbe Funktionsweise zeigt Fig. 9 für eine sphärische Oberfläche 7, wobei hier die Leitbleche 52 entsprechend der Oberflächenkrümmung eine konzentrische Wölbung aufweisen müssen, um den gleichen Effekt der laminaren Strömungsschicht zu erreichen.

Eine weitere spezielle Gestaltung von strahlformender Einrichtung ist in Fig. 10 gezeigt. Dieses Beispiel beschäftigt sich mit der effektiven Bearbeitung eines kontinuierlichen Materialflusses, bei dem entweder ein Strangprofil 72 oder ein Materialfluss identischer Werkstücke gleichzeitig an mehreren Oberflächen 7 mit einem Aktivgasstrahl 6 bearbeitet werden sollen. In Fig. 10 wird ein Strangprofil 72 durch einen geschlossenen Bearbeitungskanal 53 geführt, wobei an wenigstens zwei gegenüberliegenden Seiten dieses Bearbeitungskanals 53 schräg zur Bewegungsrichtung des Strangprofils 72 jeweils eine erfindungsgemäße Vorrichtung angebracht ist.

Alle bisher beschriebenen Anordnungen beinhalten nur den Einsatz eines Prozessgases oder Prozessgasgemisches, das direkt in die Entladungskammer 1 in entsprechender Anordnung eingeleitet wird. Soll ein zusätzlicher Stoff zugesetzt werden, der nicht in der Entladungszone 22 aktiviert werden soll, so kommen zwei mögliche Anordnungen in Frage, die entweder gemäß Fig. 11 durch Zugabe unmittelbar vor dem Begrenzungskanal 4 oder

gemäß Fig. 12 durch Einleitung direkt in den neutralen Aktivgasstrahl 6 nach dem Begrenzungskanal 4 in der Strahlformungseinrichtung 5 realisiert werden können.

Im ersten Fall (Fig. 11) wird hierzu der Zusatzstoff 8 über ein hochtemperaturfestes Zufuhrrohr 81 zugeführt, das wenige Millimeter vor dem der Entladungszone 22 zugewandten Ende des Begrenzungskanals 4 endet und aus Keramik, Quarz oder einem vergleichbar temperaturbeständigen Material besteht. Um möglichst keine Störung durch diesen Zusatzstoff 8 in der Entladungszone 22 zu erhalten, darf der Massenstrom dieses Zusatzstoffes 8 nur einen Bruchteil des Massenstroms des Prozessgases 1 in der Entladungskammer 2 ausmachen. Die Entladungskammer 2 ist in dieser Ausführungsform in ein Gehäuse 9 eingebunden, da hier eine elektrodenlose Aktivierung des Prozessgases 1 angenommen werden soll. Das Gehäuse 9 symbolisiert im einfachsten Fall einen Wellenleiter 38 mit angeschlossener Mikrowellenquelle 37 gemäß Fig. 5, kann aber auch eine Spule 39 gemäß Fig. 7 sowie eine zugehörige Kühlung aufnehmen.

Im zweiten Fall (Fig. 12) wird das aktivierte Prozessgas 1 durch einen Begrenzungskanal 4 mit mehreren parallelen Einzelkanälen 41, die in einem Ring 42 angeordnet sind, geführt. Im Zentrum des als dicke Lochplatte ausgebildeten Begrenzungskanals 4 befindet sich anstelle eines zentralen Einzelkanals 41 ein Zufuhrkanal 82, der von außen zugeleitet wird. Über diesen Zufuhrkanal 82, der innerhalb der metallischen Lochplatte des Begrenzungskanals 4 von außen in die Mitte des Ringes 42 der Einzelkanäle 41 geführt ist, wird der Zusatzstoff 8 in das Zentrum eines Aktivgasstrahls 6, der näherungsweise einen Gasring darstellt, eingebracht. Da der Aktivgasstrahl 6 bei den geringen Querschnitten der Einzelkanäle 41 mit sehr hoher Geschwindigkeit ausströmt, kann der Massenstrom des Zusatzstoffes 8 über den Zufuhrkanal 82 über einen großen Bereich variiert und sehr genau eingestellt werden.

Die Fig. 13 stellt den Längs- und Querschnitt der Vorrichtung für die Erzeugung eines elektrisch neutralen Aktivgasstrahls 6 in einem handhabbaren Gehäuse 9 dar. Die Vorrichtung besteht aus Entladungskammer 2, Begrenzungskanal 4 und Strahlformungseinrichtung 5, die als ein einheitlicher Grundkörper 91 in der Form eines griffigen Handstückes (Pen) aus Kupfer oder einem anderen sehr guten elektrischen Leiter gebildet sind, einer stabförmigen Zentralelektrode 31, die mittels eines aus Quarz bestehenden Isolatorrohres 29, coaxial zu der Wand der Entladungskammer 2, die zugleich die Hohl-elektrode 32 darstellt, angeordnet ist. Das Isolatorrohr 29 wird durch einen elastischen Dichtungsring 92 im Grundkörper 91 gasdicht bezüglich der Entladungskammer 21 abgedichtet. Das Ende der Zentralelektrode 31 steht aus dem Isolatorrohr 29 um eine Länge von bis zum zweifachen Durchmesser der Zentralelektrode 31 in die Entladungskammer 2 vor. Das Isolatorrohr 29 selbst ragt mindestens um eine Länge von der Größe des eigenen Außendurchmessers in die Entladungskammer 2 hinein und bildet somit außerhalb seiner Mantelfläche einen Teil

der Entladungskammer 2 in Form eines Hohlzylinders. In diesen Hohlzylinder nahe der hinteren Stirnwand der Entladungskammer 2 wird das Prozessgas 1 symmetrisch in die Entladungskammer 2 eingeleitet.

Das konisch verjüngte Ende 21 der Entladungskammer 2 geht fließend in den engen Begrenzungs kanal 4 über. Der Durchmesser des Begrenzungs kanals 4 steht im Verhältnis 1:8 zu dessen Länge und ist in Fig. 13 nur stilisiert (nicht maßstabsgerecht) gezeichnet. An den Begrenzungs kanal 4 schließt sich die strahlformende Einrichtung 5 an. Die Entladungskammer 2, der Begrenzungs kanal 4 und die strahlformende Einrichtung 5 sind einheitlich aus Kupfer gefertigt und weisen einen gemeinsamen geerdeten Kontakt 93 auf. Der geerdete Kontakt 93 ist zugleich mit dem negativen Pol des Spannungsgenerators 33 (in Fig. 13 nicht dargestellt) verbunden. Der positive Pol des Spannungsgenerators 33 ist an die Zentralelektrode 31 angeschlossen.

Die Zufuhr des Prozessgases 1 erfolgt über den Gaseinlass 24 zunächst in eine zylindrische Verteilungskammer 25, von der aus über gleichmäßig verteilte tangentiale Strömungskanäle 26 eine spiralförmige Gasströmung im hohlzylinderförmigen Teil der Entladungskammer 2 generiert wird. Diese Maßnahme bewirkt, dass die Fußpunkte der Bogenentladung 34 (in Fig. 13 nicht dargestellt) an der Zentralelektrode 31 auf deren Stirnfläche und unmittelbar angrenzende Teile der Elektrodenoberfläche einschränkt werden, so dass das Isolatorrohr 29 thermisch weniger belastet und dessen Erosion verringert wird.

Am rückwärtigen Ende des Grundkörpers 91 - genauer gesagt an der hinteren Stirnwand der Entladungskammer 2 ist ein isolierender Anschlusskörper 94 befestigt (z.B. geschraubt), der die Befestigung und den Anschluss der Zentralelektrode 31 trägt. Der Anschlusskörper 94 weist einen zusätzlichen Gaseinlass 27 auf, der über eine schmale Ringkammer 28 entlang der Zentralelektrode 31 mit der Entladungskammer 2 verbunden ist. Durch diese schmale Ringkammer 28 wird zwischen Zentralelektrode 31 und Isolatorrohr 29 ein Teil des Prozessgases 1 mit der Funktion einer Elektrodenkühlung und direkter Einspeisung in die Entladungszone 22 zugeführt. Die Ringkammer 28 wird rückwärtig im Anschlusskörper 94 durch einen elastischen Ring 96 gegen die Zentralelektrode 31, die nach hinten zur Anschlussklemme 95 hindurch geführt ist, abgedichtet. Auch in die Ringkammer 28 können - wie zwischen der Verteilungskammer 25 und dem hohlzylindrischen Teil der Entladungskammer 2 - tangentiale Strömungskanäle 26 (für Ringkammer 28 nicht dargestellt) zur Erzeugung einer spiralförmigen Gaszirkulation vorgesehen sein.

Die Vorrichtung nach Fig. 13 funktioniert nun in folgender Art und Weise. Ein Teil des Prozessgases 1 wird durch den zusätzlichen Gaseinlass 27 zugeführt und strömt durch die Ringkammer 28 zwischen der Zentralelektrode 31 und dem Isolatorrohr 29 in die Entladungskammer 2. Gleichzeitig wird der andere (größere) Teil des Prozessgases 1 durch den Gaseinlass 24 über die Verteilungs-

kammer 25, durch die tangentialen Öffnungen 26 der Entladungskammer 2 in deren hohlzylinderförmigen Teil, der durch die Hohlelektrode 32 und das hereinragende Isolatorrohr 29 gebildet wird, zugeführt. Dadurch wird eine spiralförmige Wirbelströmung in der Entladungskammer 2 erzeugt. Bei der Zufuhr des Prozessgases 1 durch die Gaseinlässe 24 und 27 und gleichzeitigem Anliegen einer Gleichspannung zwischen geerdetem Kontakt 93 und Anschlussklemme 95 entsteht eine elektrische Entladung in der Entladungskammer 2. Das Prozessgas 1 wird aufgrund der Wechselwirkungen in der Entladungszone 22 (analog zu Fig. 2, jedoch in Fig. 13 nicht dargestellt) aktiviert, verlässt die Entladungskammer 2 - durch deren konisch verjüngtes Ende 21 beschleunigt - mit hoher Geschwindigkeit und strömt durch den anschließenden Begrenzungs kanal 4 sowie die strahlformende Einrichtung 5 in den (freien) Bearbeitungsraum. Der Aktivgasstrahl 6 verliert im Wesentlichen im Begrenzungs kanal 4 sein Potential, dessen Größe am Ende des Begrenzungs kanals 4 gegenüber Masse (geerdet) nahezu Null ist. In der nachfolgenden strahlformenden Einrichtung 5 wird der Aktivgasstrahl 6 dann auf die für die Anwendung gewünschte Breite und Form (wie beispielhaft zu den Figuren 7 bis 9 beschrieben) gebracht. Damit steht ein chemisch sehr wirkungsvoller und elektrisch neutraler Aktivgasstrahl 6 für beliebige Anwendungsfälle zur Verfügung.

Liste der verwendeten Bezugszeichen

[0016]

1 Prozessgas

2 Entladungskammer
21 konisch verjüngtes Ende
22 Entladungszone
23 Auswölbung der Entladungszone
24 tangentiale Strömungskanäle
25 Verteilungskammer
26, 27 Gaseinlass
28 Ringkammer
29 Isoiatorrohr

3 Feld
31 Zentralelektrode
32 Hohlelektrode
33 Spannungsgenerator
34 Bogenentladung
35 HF-Elektrode
36 HF-Quelle
37 Mikrowellenquelle
38 Mikrowellenleiter
39 Spule

4 Begrenzungs kanal
41 Einzelkanäle
42 Ring (von Einzelkanälen)

5 strahlformende Einrichtung
 51 verzweigte Düsen
 52 Leitbleche
 53 Bearbeitungskanal

6 Aktivgasstrahl
 61 Teilstrahlen

7 Oberfläche
 71 Teilflächen
 72 Strangprofil

8 Zusatzstoffe
 81 Zufuhrrohr
 82 Zufuhrkanal

9 Gehäuse
 91 Grundkörper
 92 elastischer Dichtungsring
 93 Erdungsklemme
 94 isolierender Anschlusskörper
 95 Anschlussklemme (der Zentralelektrode)
 96 elastischer Ring

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Erzeugen eines chemisch aktiven Strahls (6) mittels eines durch elektrische Entladung generierten Plasmas in einem verwendeten Prozessgas mit einer im Wesentlichen zylindrischen Entladungskammer, die von einem Prozessgas durchströmt wird und in der zur Aktivierung des Prozessgases eine Plasmaerzeugung infolge einer elektrischen Gasentladung vorgesehen ist, einem Gaseinlass zum kontinuierlichen Zuführen des Prozessgases in die Entladungskammer sowie einer Austrittsöffnung zum Ausrichten des chemisch aktiven Strahls (6) auf eine zu bearbeitende Oberfläche, wobei

- die Entladungskammer (2) ein konisch verjüngtes Ende (21) zur Erhöhung der Geschwindigkeit des chemisch aktiven Strahls (6) aufweist und
- dem verjüngten Ende (21) der Entladungskammer (2) ein Begrenzungskanal (4) zur Verhinderung der Ausbreitung der Entladungszone (22) in den freien Raum für die zu bearbeitende Oberfläche (7) nachgeordnet ist, wobei der Begrenzungskanal (4) im Wesentlichen zylindrisch ausgebildet, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Begrenzungskanal (4) geerdet ist und dessen Länge um den Faktor 5 bis 10 größer als sein Querschnitt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei zur Aktivierung des Prozessgases (1) eine Bogen-

entladung (34) vorgesehen ist, wobei die Entladungskammer (2) eine Zentralelektrode (31) und eine Hohlelektrode (32), die die Innenwand der Entladungskammer (2) mindestens im Bereich des konisch verjüngten Endes (21) flächig und symmetrisch bedeckt, aufweist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei der Begrenzungskanal (4) direkt an die Hohlelektrode (32) angefügt ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Zentralelektrode (31) stabförmig ausgebildet und entlang der Symmetrieachse der Entladungskammer (2) angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Zentralelektrode (31) die Form einer Zylinderkappe aufweist, die eine Zylindermantelfläche geringer Höhe sowie eine Deckfläche beinhaltet und deren Öffnung coaxial zur Symmetrieachse der Entladungskammer (2) ausgerichtet und oberhalb des Gaseinlasses (26) der Entladungskammer (2) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei zur Aktivierung des Prozessgases (1) die Entladungskammer (2) in einem mit Hochfrequenz (Radiofrequenz) erzeugten Induktionsfeld angebracht ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei zur Aktivierung des Prozessgases (1) die Entladungskammer (2) mit zwei entlang der Wand der Entladungskammer (2) in Strömungsrichtung des Prozessgases (1) angeordneten HF-Elektroden (35), die mit Radiofrequenz betrieben werden, versehen ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei zur Aktivierung des Prozessgases (1) die Entladungskammer (2) in einer mit Hochfrequenz betriebenen Spule (39) angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei zur Aktivierung des Prozessgases (1) die Entladungskammer (2) in einem an einer Mikrowellenquelle (37) angeschlossenen Wellenleiter (38) angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei dem Begrenzungskanal (4) eine strahlformende Einrichtung (5) zur Einstellung des chemisch aktiven Strahls (6) mit gewünschten Parametern, insbesondere Geschwindigkeit, Temperatur, geometrische Form und Strömungsart, nachgeordnet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, weiterhin gekenn-

- zeichnet, dass
an den Ausgang des Begrenzungskanal (4) verzweigte Düsen (51) zum Bearbeiten einzelner Teilflächen (71) oder Vertiefungen der zu bearbeitenden Oberfläche (7) angeschlossen sind.
- 12.** Vorrichtung nach Anspruch 10, weiterhin gekennzeichnet, dass
die strahlformende Einrichtung (5) durch Leitbleche (52) an die Form der zu bearbeitenden Oberfläche (7) angepasst ist, wobei der Abstand zwischen der Oberfläche (7) und den Leitblechen (52) in einem definiert kleinen Bereich gehalten wird, so dass die effektiv behandelte Oberfläche (7) eine größere Fläche umfasst.
- 13.** Vorrichtung nach Anspruch 10, weiterhin gekennzeichnet, dass
strahlformende Einrichtungen (5) vorgesehen sind, die zwei oder mehrere erfindungsgemäße Vorrichtungen zur Erzeugung des chemisch aktiven Strahls (6) in einen Bearbeitungskanal (53) einbinden, wobei in dem Bearbeitungskanal (53) bei kontinuierlichem Materialdurchlauf mehrere zu behandelnde Oberflächen (7) eines Werkstücks gleichzeitig oder Oberflächen (7) von Strangprofilen (72) mit beliebigem Querschnitt allseitig bearbeitbar sind.
- 14.** Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei
ein in der Entladungskammer (2) axial angeordnetes Zufuhrrohr (81), das kurz vor dem Ausgang der Entladungskammer (2) endet, zur Einbringung von Zusatzstoffen (8) in den chemisch aktiven Strahl (6) vorgesehen ist, wobei ein Einfluss der Zusatzstoffe (8) auf die Entladungscharakteristik und eine Kontaminierung der Entladungskammer (2) durch die Zusatzstoffe (8) oder deren Reaktionsprodukte vermieden wird.
- 15.** Vorrichtung nach Anspruch 1, weiterhin gekennzeichnet, dass
der Begrenzungskanal (4) mehrere Einzelkanäle (41) umfasst, um den gasdynamischen Widerstand und die Verweildauer des chemisch aktiven Strahls (6) im Begrenzungskanal (4) zu reduzieren, wobei die Einzelkanäle (41) um einen zentralen Kanal herum gleichmäßig in einem Ring (42) verteilt angeordnet sind.
- 16.** Vorrichtung nach Anspruch 15, weiterhin gekennzeichnet, dass
der Begrenzungskanal (4) mit mehreren Einzelkanälen (41) einen zentralen Zufuhrkanal (82) für Zusatzstoffe (8) aufweist, wobei der Zufuhrkanal (82) axial im Zentrum des Ringes (42) von mit aktiviertem Prozessgas (6) durchströmten Einzelkanälen (41) angeordnet ist.
- 17.** Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 16, wobei
die Zusatzstoffe (8) im Bereich des Begrenzungskanal (4) als Gase, Flüssigkeiten in Form von Aerosolen oder Feststoffe in Form feiner Partikel einführbar sind.
- 18.** Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei
die Hohlelektrode (32), der Begrenzungskanal (4) und die strahlformende Einrichtung (5) als einheitlicher Rotationskörper mit sehr guter elektrischer Leitfähigkeit gefertigt sind, die Zentralelektrode (31) als koaxial von einem Isolatorrohr (29) umgebene stabförmige Zentralelektrode (31) in die Entladungskammer (2), die von der Hohlelektrode (32) gebildet wird, eingeführt ist, und die Gaszufuhr für das Prozessgas (1) tangentielle Strömungskanäle (24) in einer die Zentralelektrode (31) konzentrisch umgebenden zylindrischen Verteilungskammer (15; 16) aufweist, wobei infolge einer resultierenden spiralförmigen Gasströmung aus der Verteilungskammer (15; 16) in die Entladungskammer (2) Bogenentladungen (34) zwischen Zentralelektrode (31) und Hohlelektrode (32) einen auf das Ende der Zentralelektrode (31) konzentrierten Austrittsbereich aufweisen.
- 19.** Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei
tangentielle Strömungskanäle (24) in einen zylindrischen ringförmigen Teil der Entladungskammer (2) zwischen innerer Oberfläche der Hohlelektrode (32) und äußerer Oberfläche des Isolatorrohres (29) geführt sind, so dass das Prozessgas (1) das Isolatorrohr (29) von außen spiralförmig umströmt.
- 20.** Vorrichtung nach den Anspruch 18, wobei
tangentielle Strömungskanäle (24) zusätzlich in eine zylindrische Ringkammer (28) zwischen stabförmiger Zentralelektrode (31) und innerer Oberfläche des Isolatorrohres (29) geführt sind, so dass die Zentralelektrode (31) direkt von einem Anteil des Prozessgases (1) gekühlt wird und Austrittspunkte von Bogenentladungen (34) im Wesentlichen auf nicht-zylindrische Flächen der Zentralelektrode (31) beschränkt sind.
- 21.** Vorrichtung nach Anspruch 19, wobei
das Ende der stabförmigen Zentralelektrode (31) das Isolatorrohr (29) um eine Länge von bis zum zweifachen Durchmesser der Zentralelektrode (31) überragt.
- 22.** Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, wobei
das Ende der Zentralelektrode (31) mit dem Ende des Isolatorrohres (29) abschließt.
- 23.** Vorrichtung nach Anspruch 18, weiterhin gekennzeichnet, dass
der Begrenzungskanal (4) in Gasströmungsrichtung leicht kegelförmig verengt ist und ein mittleres Ver-

hältnis von Kanaldurchmesser zu Kanallänge von 1: 8 aufweist.

24. Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei dem Begrenzungskanal (4) eine strahlformende Einrichtung (5) mit glockenförmig erweitertem Ausgang nachgeordnet ist, so dass die Arbeitsbreite des chemisch aktiven Strahls (6) vergrößert ist.

Claims

1. Device for generating a chemically active jet (6) by a plasma generated by electric discharge in a utilized process gas, said device comprising a substantially cylindrical discharge chamber through which process gas flows and in which plasma is generated due to an electric gas discharge for activating the process gas; a gas inlet for continuously feeding the process gas into the discharge chamber, and an outlet opening for directing the chemically active jet (6) to a surface to be treated,

- said discharge chamber (2) having a conically narrowed end (21) for increasing the velocity of the chemically active jet (6), and
- a limiting channel (4) for preventing propagation of the discharge zone (22) into the free space for the surface (7) to be treated being arranged following the narrowed end (21) of the discharge chamber (2), said limiting channel (4) being substantially cylindrical, **characterized in that** said limiting channel (4) is grounded and its length is greater than its cross section by a factor of 5 - 10.

2. Device according to claim 1, wherein an arc discharge (34) is provided for activating the process gas (1) and the discharge chamber (2) comprises a center electrode (31) and a hollow electrode (32) which covers the inner wall of the discharge chamber (2) in a planar and symmetrical manner at least in the area of the conically narrowed end (21).
3. Device according to claim 2, wherein the limiting channel (4) directly adjoins the hollow electrode (32).
4. Device according to claim 2, wherein the center electrode (31) is rod-shaped and is arranged along the axis of symmetry of the discharge chamber (2).
5. Device according to claim 2, wherein the center electrode (31) has the shape of a cylinder cap, which includes an outer cylindrical surface of low height and a cover surface and whose opening is oriented coaxially to the axis of symmetry of the discharge chamber (2) and arranged above the gas inlet (26) of the discharge chamber (2).

6. Device according to claim 1, wherein, in order to activate the process gas (1), the discharge chamber (2) is arranged in an induction field generated by high frequency (radio frequency).

7. Device according to claim 6, wherein, in order to activate the process gas (1), the discharge chamber (2) is provided with two HF electrodes (35) which are arranged along the wall of the discharge chamber (2) in the direction of flow of the process gas (1) and which are operated at radio frequency.

8. Device according to claim 6, wherein, in order to activate the process gas (1), the discharge chamber (2) is arranged in a coil (39) operated at high frequency.

9. Device according to claim 1, wherein, in order to activate the process gas (1), the discharge chamber (2) is arranged in a waveguide (38) connected to a microwave source (37).

10. Device according to claim 1, wherein a jet-shaping unit (5) is arranged following the limiting channel (4) for adjusting the chemically active jet (6) with desired parameters, particularly velocity, temperature, geometric shape and type of flow.

11. Device according to claim 10, further **characterized in that** branched nozzles (51) are connected to the output of the limiting channel (4) for treating individual partial surfaces (71) or depressions in the surface (7) to be treated.

12. Device according to claim 10, further **characterized in that** the jet-shaping unit (5) is adapted to the shape of the surface (7) to be treated by means of guiding plates (52), and the distance between the surface (7) and the guiding plates (52) is kept within a defined small range, so that the effectively treated surface (7) covers a larger area.

13. Device according to claim 10, further **characterized in that** jet-shaping units (5) are provided which integrate two or more of the inventive devices for generating the chemically active jet (6) in one treatment channel (53), wherein, with continuous throughput of material, a plurality of workpiece surfaces (7) to be treated can be treated simultaneously in the treatment channel (53), or surfaces (7) of continuous sections (72) with any desired cross section can be treated on all sides in the treatment channel (53).

14. Device according to claim 1, wherein a feed pipe (81) which ends shortly before the output of the discharge chamber (2) is arranged axially in the discharge chamber (2) for introducing additives (8) in the chemically active jet (6), wherein the additives (8) are pre-

vented from influencing the discharge characteristic and the additives (8) or their reaction products are prevented from contaminating the discharge chamber (2).

15. Device according to claim 1, further **characterized in that** the limiting channel (4) comprises a plurality of individual channels (41) in order to reduce the gas-dynamic resistance and the dwelling time of the chemically active jet (6) in the limiting channel (4), wherein the individual channels (41) are arranged so as to be uniformly distributed in a ring (42) around a central channel.

16. Device according to claim 15, further **characterized in that** the limiting channel (4) with a plurality of individual channels (41) has a central feed channel (82) for additives (8), wherein the feed channel (82) is arranged axially in the center of the ring (42) of individual channels (41) through which activated process gas (6) flows.

17. Device according to claim 14 or 16, wherein the additives (8) can be introduced into the area of the limiting channel (4) as gases, liquids in the form of aerosols, or solids in the form of fine particles.

18. Device according to claim 4, wherein the hollow electrode (32), the limiting channel (4) and the jet-shaping unit (5) are manufactured as a uniform rotating body with very good electrical conductivity, the center electrode (31) is introduced into the discharge chamber (2), formed by the hollow electrode (32), as a rod-shaped center electrode (31) enclosed coaxially by an insulating pipe (29), and the gas feed for the process gas (1) has tangential flow channels (24) in a cylindrical distribution chamber (15; 16) concentrically enclosing the center electrode (31), wherein arc discharges (34) between the center electrode (31) and hollow electrode (32) have an outlet area concentrated on the end of the center electrode (31) due to a resulting spiral-shaped gas flow from the distribution chamber (15; 16) into the discharge chamber (2).

19. Device according to claim 18, wherein tangential flow channels (24) are guided into a cylindrical, annular portion of the discharge chamber (2) between the inner surface of the hollow electrode (32) and the outer surface of the insulating pipe (29), so that the process gas (1) circulates externally around the insulating pipe (29) in a spiral-shaped manner.

20. Device according to claim 18, wherein tangential flow channels (24) are guided in addition into a cylindrical, annular chamber (28) between the rod-shaped center electrode (31) and the inner surface of the insulating pipe (29), so that the center electrode (31) is

cooled directly by a proportion of the process gas (1) and outlet points of arc discharges (34) are substantially confined to noncylindrical surfaces of the center electrode (31).

21. Device according to claim 19, wherein the end of the rod-shaped center electrode (31) protrudes over the insulating pipe (29) by a length of up to twice the diameter of the center electrode (31).

22. Device according to claim 19 or 20, wherein the end of the center electrode (31) terminates with the end of the insulating pipe (29).

23. Device according to claim 18, further **characterized in that** the limiting channel (4) is slightly conically narrowed in the direction of gas flow and has an average ratio of channel diameter to channel length of 1:8.

24. Device according to claim 18, wherein a jet-shaping unit (5) with an outlet that widens in a bell-shaped manner is arranged downstream of the limiting channel (4), so that the working width of the chemically active jet (6) is increased.

Revendications

1. Dispositif de production d'un jet chimiquement actif (6) au moyen d'un plasma produit par décharge électrique dans un gaz de procédé utilisé, ledit dispositif comprenant une chambre de décharge sensiblement cylindrique, qui est traversée par un gaz de procédé et dans laquelle un plasma est produit par une décharge électrique gazeuse afin d'activer le gaz de procédé; une entrée de gaz pour l'alimentation continue de la chambre de décharge en gaz de procédé, et une orifice de sortie pour diriger le jet chimiquement actif (6) vers une surface à traiter,

- ladite chambre de décharge (2) présentant une extrémité (21) coniquement rétrécie pour augmenter la vitesse du jet chimiquement actif (6), et

- un canal limiteur (4) étant disposé en aval de l'extrémité (21) rétrécie de la chambre de décharge (2) de manière à éviter la propagation de la zone de décharge (22) dans l'espace libre pour la surface (7) à traiter, ledit canal limiteur (4) étant sensiblement cylindrique, **caractérisé en ce que** ledit canal limiteur (4) est mis à la terre et **en ce que** sa longueur est supérieure à sa section transversale d'un facteur de 5 - 10.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel une décharge en arc (34) est prévue afin d'activer le gaz de procédé (1), et la chambre de décharge (2) com-

- prend une électrode centrale (31) et une électrode creuse (32) qui couvre la paroi interne de la chambre de décharge (2) d'une manière planaire et symétrique au moins dans la région de l'extrémité (21) co-niquement rétrécie.
3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel le canal limiteur (4) est joint directement à l'électrode creuse (32).
 4. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel l'électrode centrale (31) est en forme de barreau et est disposée le long de l'axe de symétrie de la chambre de décharge (2).
 5. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel l'électrode centrale (31) présente la forme d'un capuchon cylindrique, qui comprend une enveloppe de cylindre de faible hauteur ainsi qu'une base et dont l'ouverture est orientée de manière coaxiale à l'axe de symétrie de la chambre de décharge (2) et disposée au-dessus de l'entrée de gaz (26) de la chambre de décharge (2).
 6. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel, pour activer le gaz de procédé (1), la chambre de décharge (2) est disposée dans un champ d'induction, qui est produit par haute fréquence (radiofréquence).
 7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel, pour activer le gaz de procédé (1), la chambre de décharge (2) présente deux électrodes HF (35), qui sont disposées le long de la paroi de la chambre de décharge (2) dans la direction d'écoulement du gaz de procédé (1) et qui fonctionnent en radiofréquence.
 8. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel, pour activer le gaz de procédé (1), la chambre de décharge (2) est disposée dans une bobine (39) qui fonctionne en haute fréquence.
 9. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel, pour activer le gaz de procédé (1), la chambre de décharge (2) est disposée dans un guide d'onde (38) raccordé à une source de micro-ondes (37).
 10. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel un moyen de formation d'un jet (5) est disposé en aval du canal limiteur (4) pour le réglage du jet chimiquement actif (6) selon des paramètres désirés, notamment la vitesse, la température, la forme géométrique et le type d'écoulement.
 11. Dispositif selon la revendication 10, **caractérisé en outre en ce que** des buses de branchement (51) sont raccordées à la sortie du canal limiteur (4) pour le traitement individuel de surfaces partielles (71) ou de concavités dans la surface (7) à traiter.
 12. Dispositif selon la revendication 10, **caractérisé en outre en ce que** le moyen de formation d'un jet (5) est adapté à la forme de la surface (7) à traiter au moyen de tôles de guidage (52), et la distance entre la surface (7) et les tôles de guidage (52) est tenue dans une gamme étroite définie, de sorte que la surface (7) effectivement traitée renferme une plus grande surface.
 13. Dispositif selon la revendication 10, **caractérisé en outre en ce que** l'on prévoit des moyens de formation d'un jet (5) qui intègrent deux ou plus de deux dispositifs de production d'un jet chimiquement actif (6) selon l'invention dans un seul canal de traitement (53), ce qui permet, étant donné un passage continu de matériau, le traitement simultané dans le canal de traitement (53) de plusieurs surfaces (7) à traiter d'une pièce fabriquée, ou le traitement de tout côté de surfaces (7) de profils extrudés (72) de n'importe quelle section transversale dans le canal de traitement (53).
 14. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel un tuyau d'alimentation (81) qui se termine une faible distance en amont de la sortie de la chambre de décharge (2) est axialement disposé dans la chambre de décharge (2) afin d'introduire des additifs (8) dans le jet chimiquement actif (6), évitant en même temps une influence desdits additifs (8) sur la caractéristique de décharge et une contamination de la chambre de décharge (2) avec les additifs (8) ou leurs produits de réaction.
 15. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en outre en ce que** le canal limiteur (4) comprend plusieurs canaux individuels (41) afin de réduire la résistance à cause de la dynamique des gaz et le temps de séjour du jet chimiquement actif (6) dans le canal limiteur (4), les canaux individuels (41) étant uniformément répartis sous la forme d'un anneau (42) entourant un canal central.
 16. Dispositif selon la revendication 15, **caractérisé en outre en ce que** le canal limiteur (4) avec plusieurs canaux individuels (41) comprend un canal central d'alimentation (82) en additifs (8), ledit canal d'alimentation (82) étant disposé axialement au centre de l'anneau (42) de canaux individuels (41) à travers lesquels passe le gaz de procédé (6) activé.
 17. Dispositif selon la revendication 14 ou 16, dans lequel les additifs (8) peuvent être introduits dans la zone du canal limiteur (4) comme des gaz, des liquides sous forme d'aérosols ou comme des solides sous forme de fines particules.
 18. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel l'électrode creuse (32), le canal limiteur (4) et le moyen

de formation d'un jet (5) sont fabriqués comme un corps de révolution uniforme présentant une très bonne conductibilité électrique, l'électrode centrale (31) est introduite dans la chambre de décharge (2), formée par l'électrode creuse (32), comme électrode centrale (31) en forme de barreau coaxialement enfermée dans un tube isolant (29), et l'alimentation en gaz pour le gaz de procédé (1) présente des canaux d'écoulement tangentiels (24) dans une chambre de distribution cylindrique (15; 16) entourant l'électrode centrale (31) de manière concentrique, les décharges en arc (34) entre l'électrode centrale (31) et l'électrode creuse (32) présentant une zone de sortie concentrée sur l'extrémité de l'électrode centrale (31) à cause d'une fleuve gazeuse résultante en spirale de la chambre de distribution (15; 16) jusque dans la chambre de décharge (2).

travail du jet chimiquement actif (6).

19. Dispositif selon la revendication 18, dans lequel les canaux d'écoulement tangentiels (24) sont amenés dans une partie cylindrique annulaire de la chambre de décharge (2) entre la surface intérieure de l'électrode creuse (32) et la surface extérieure du tube isolant (29), de sorte que le gaz de procédé (1) circule en spirale autour de l'extérieur du tube isolant (29).
20. Dispositif selon la revendication 18, dans lequel les canaux d'écoulement tangentiels (24) sont amenés en outre dans une chambre annulaire cylindrique (28) entre l'électrode centrale (31) en forme de barreau et la surface intérieure du tube isolant (29), de sorte que l'électrode centrale (31) soit refroidie directement par une partie du gaz de procédé (1) et les points de sortie de décharges en arc (34) sont limités sensiblement à des surfaces non pas cylindriques de l'électrode centrale (31).
21. Dispositif selon la revendication 19, dans lequel l'extrémité de l'électrode centrale (31) en forme de barreau fait saillie au-delà du tube isolant (29) sur une longueur maximale de deux fois le diamètre de l'électrode centrale (31).
22. Dispositif selon la revendication 19 ou 20, dans lequel l'extrémité de l'électrode centrale (31) est au ras de l'extrémité du tube isolant (29).
23. Dispositif selon la revendication 18, dans lequel le canal limiteur (4) est faiblement rétrécie de manière conique dans la direction d'écoulement du gaz et en ce qu'il présente un rapport moyen du diamètre du canal à sa longueur de 1:8.
24. Dispositif selon la revendication 18, dans lequel un moyen de formation d'un jet (5) avec une sortie élargie en forme de cloche est disposé en aval du canal limiteur (4) de manière à augmenter la largeur de

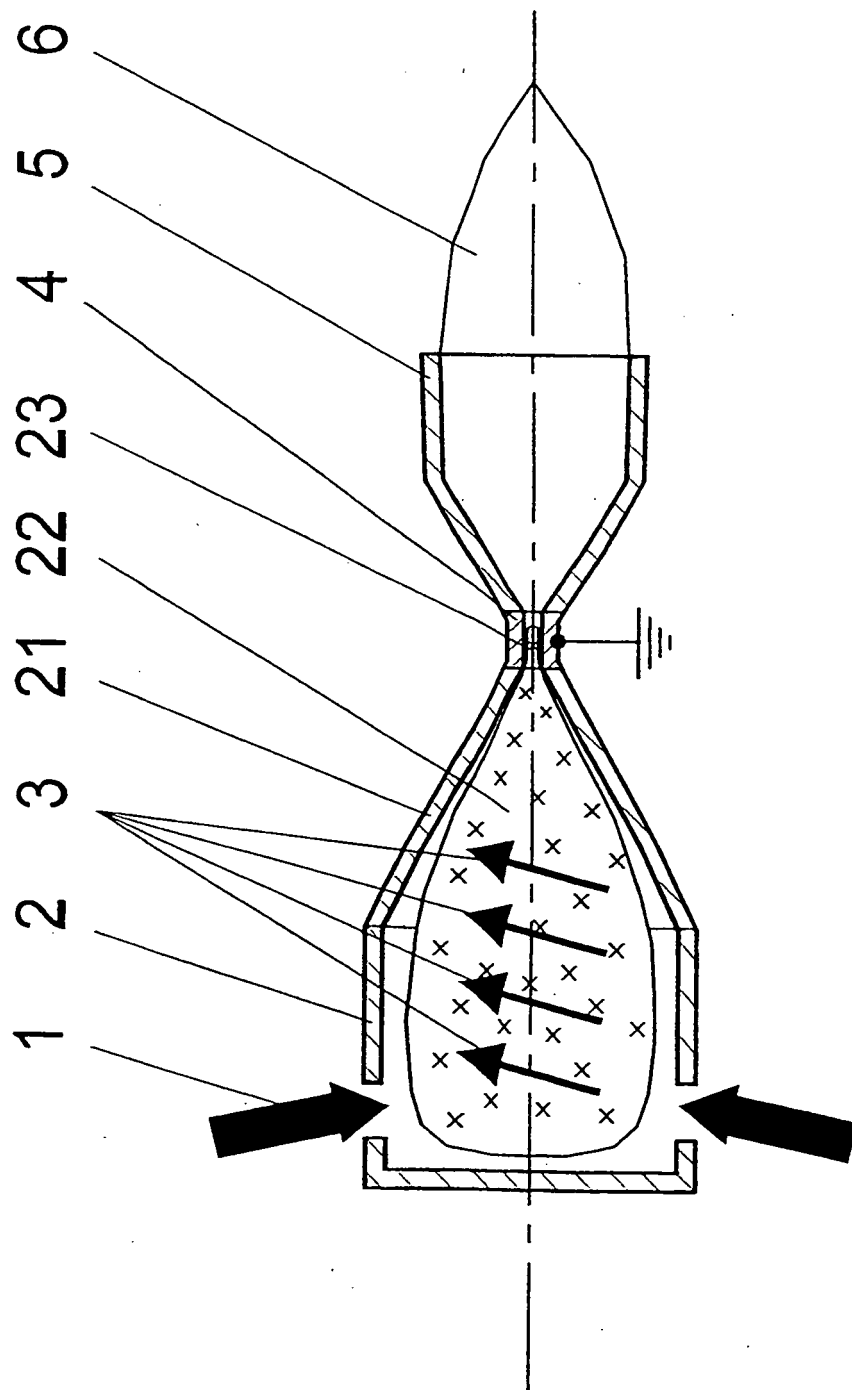


Fig. 1

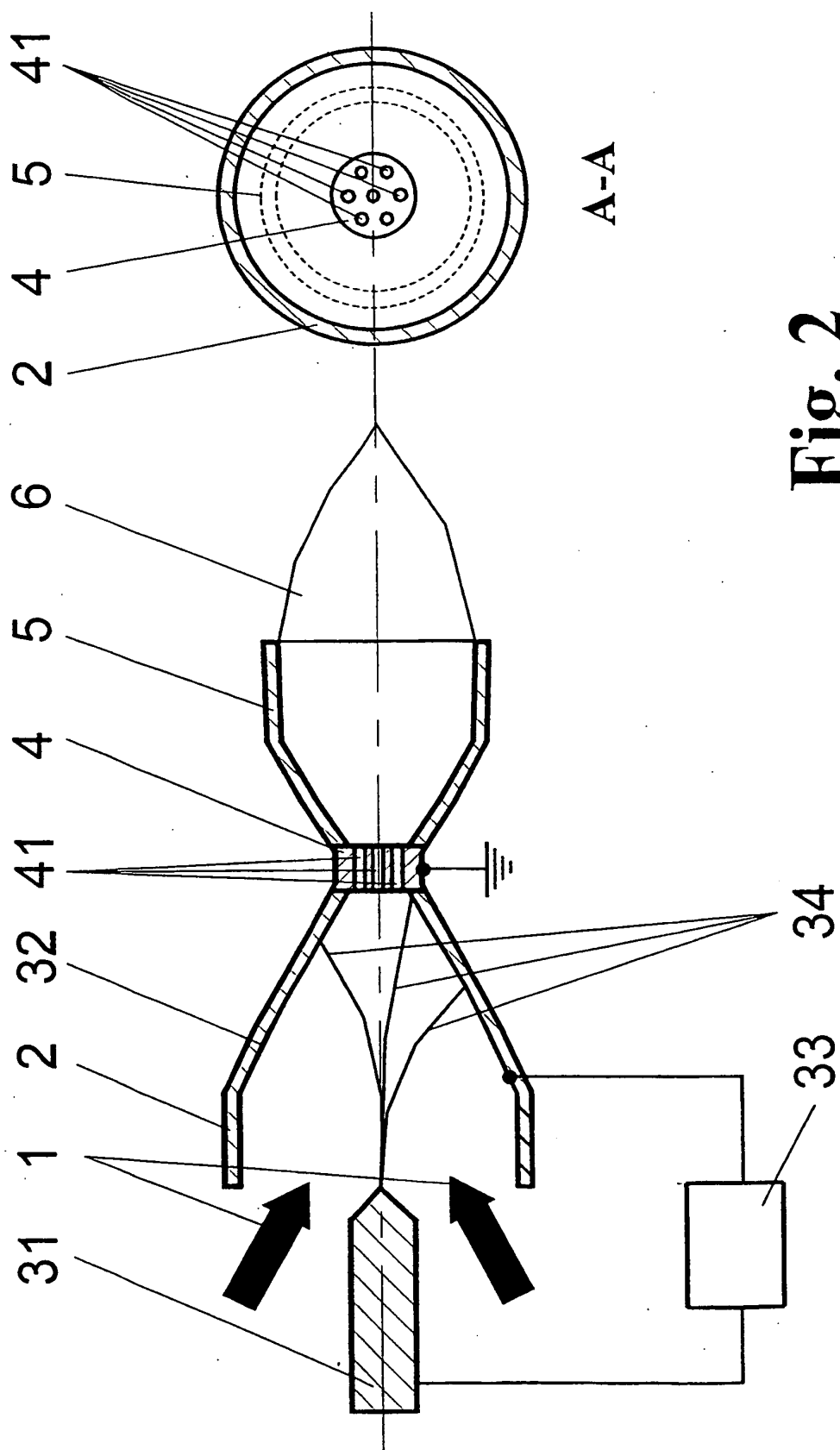


Fig. 2

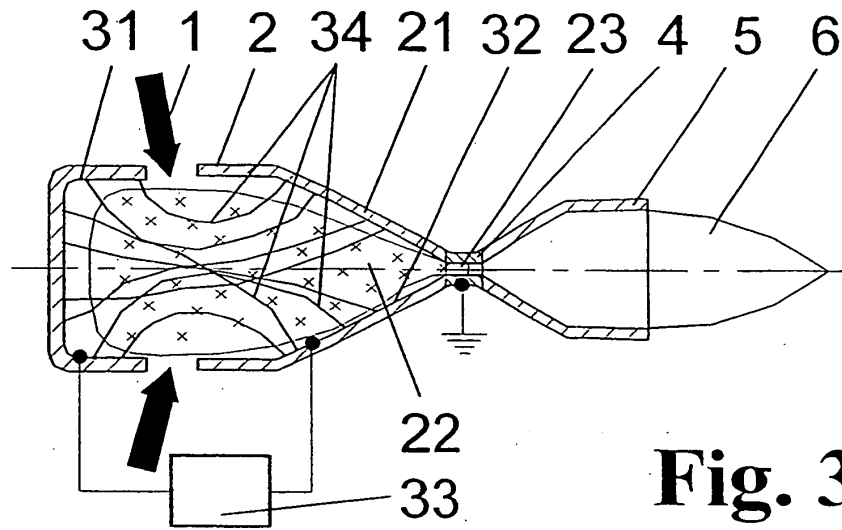


Fig. 3

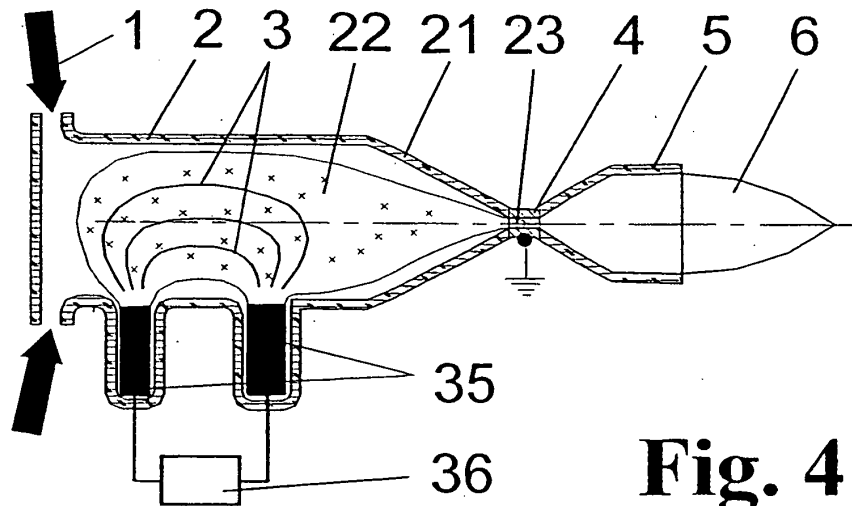


Fig. 4

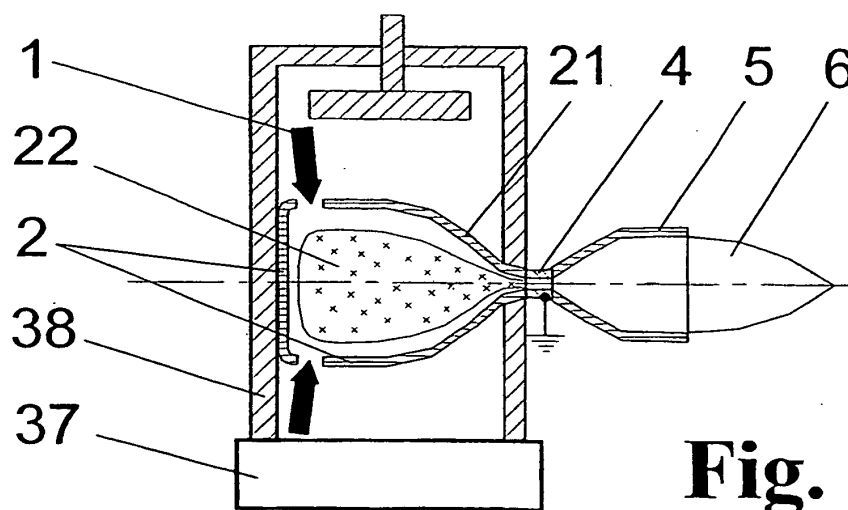


Fig. 5

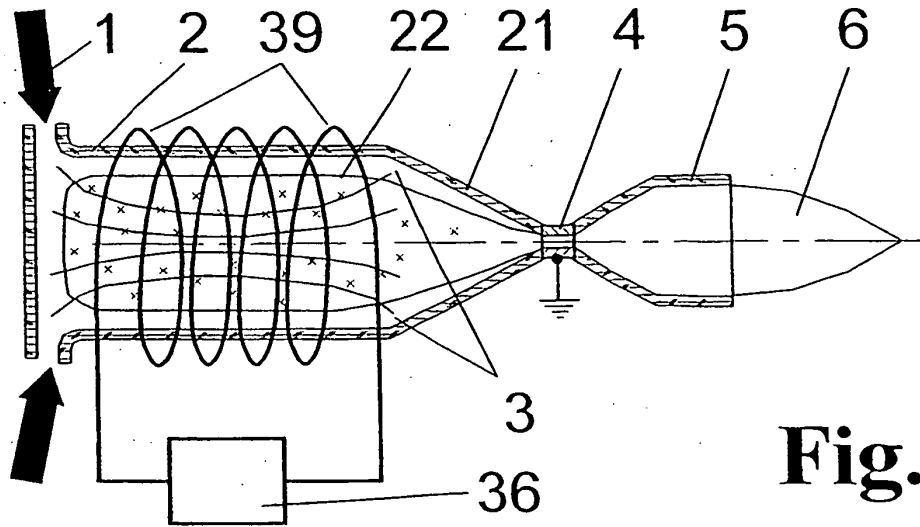


Fig. 6

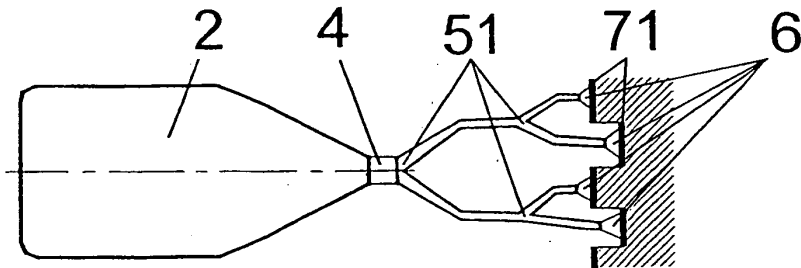


Fig. 7

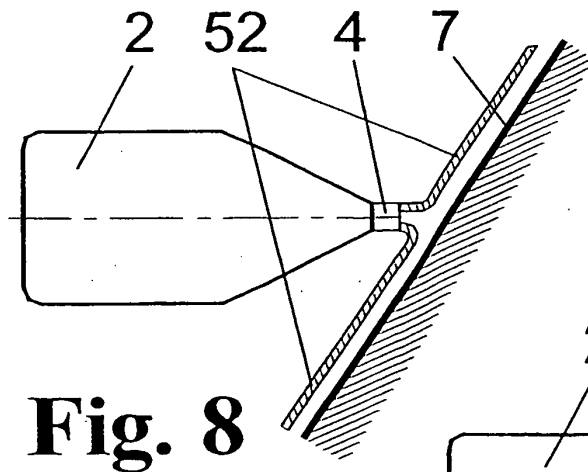


Fig. 8

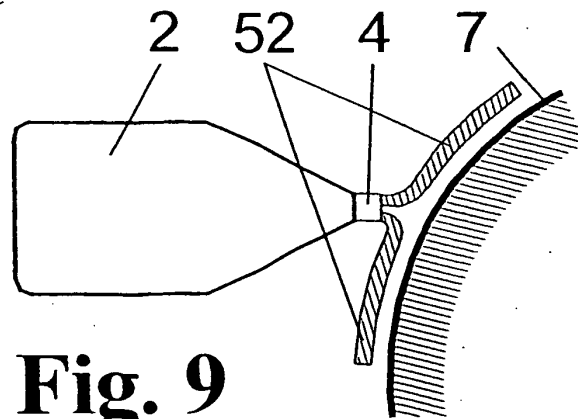


Fig. 9

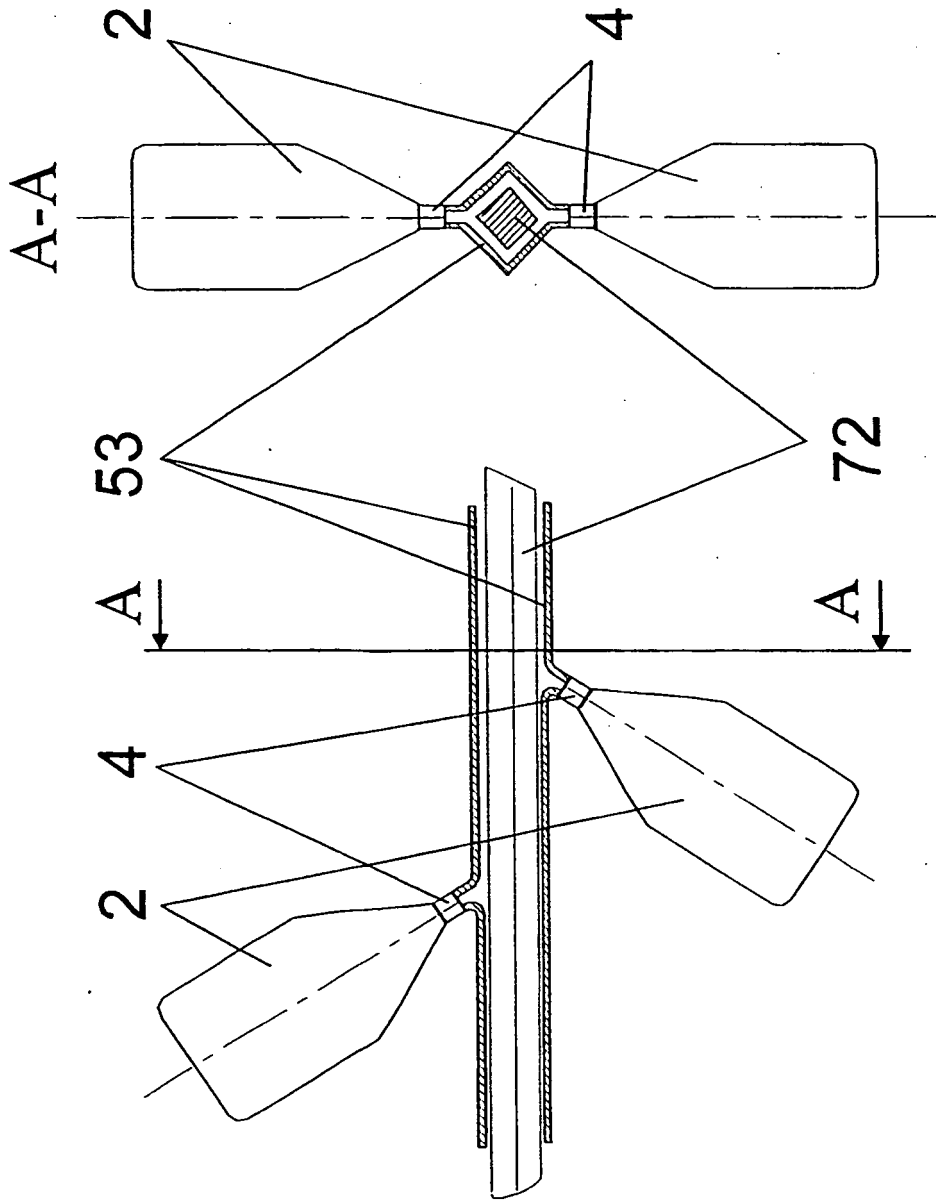


Fig. 10

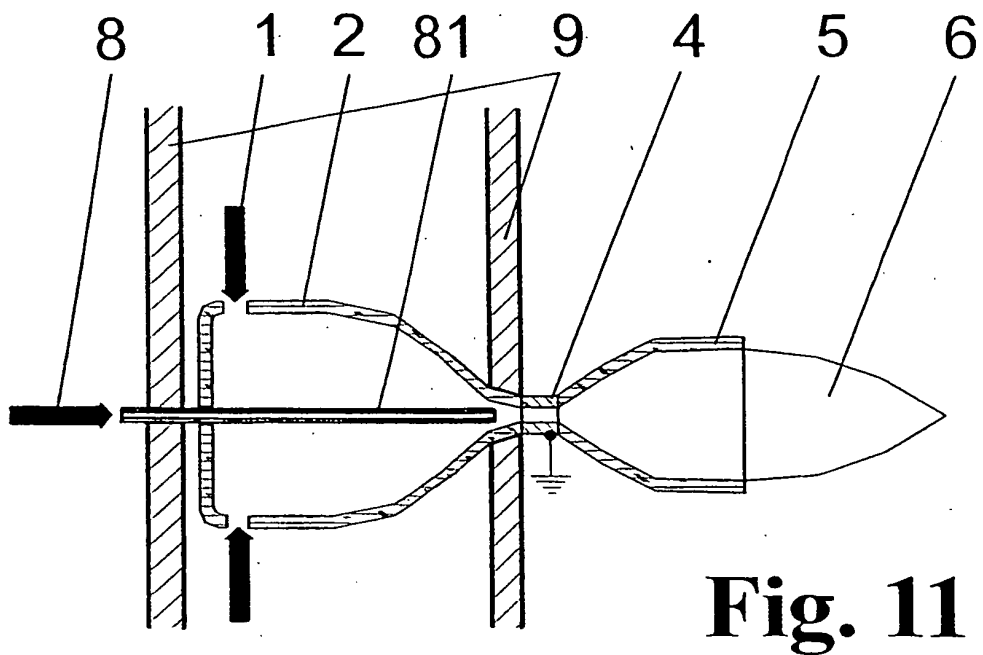


Fig. 11

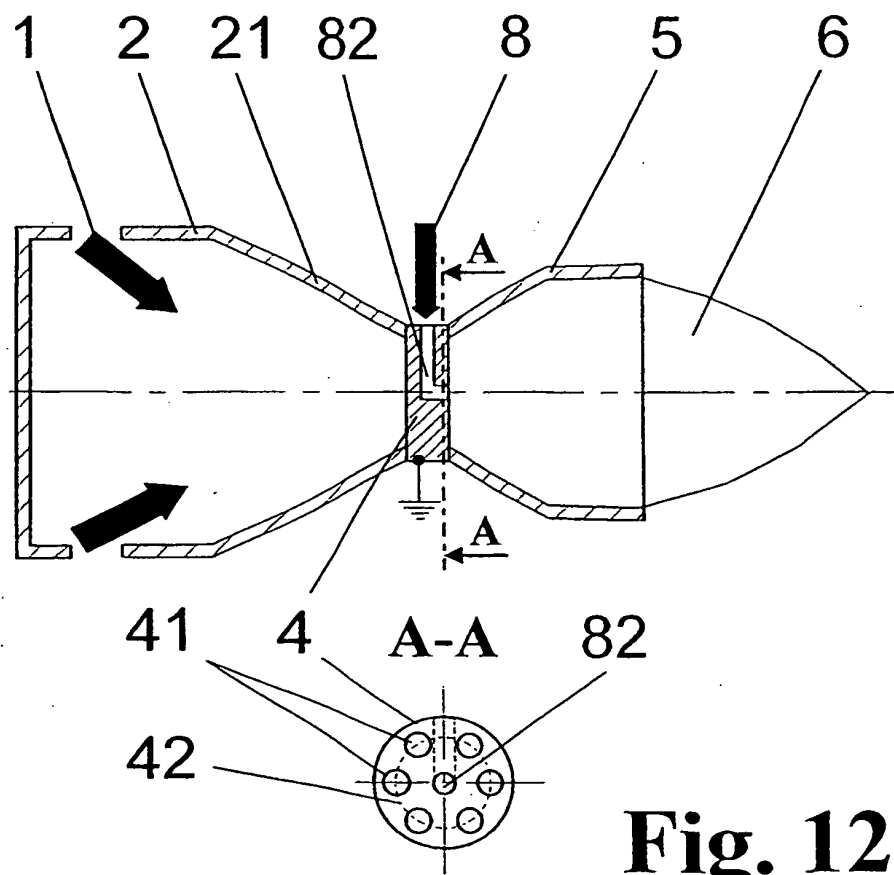


Fig. 12

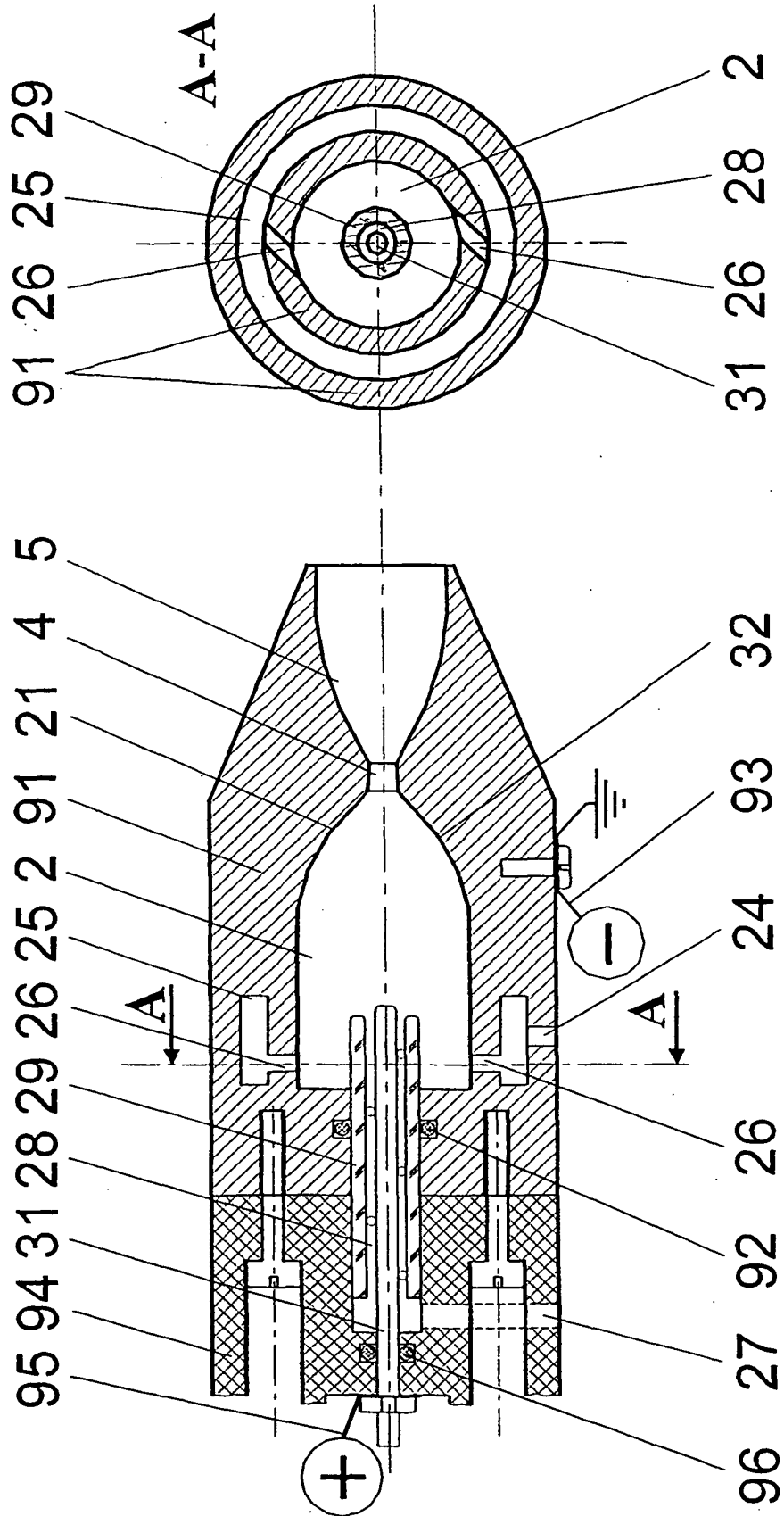


Fig. 13

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 19546930 C1 [0002] [0015]
- DE 19532412 A1 [0002] [0015]
- EP 0305241 A [0002] [0003]
- DE 29919142 [0002]
- EP 0305241 A1 [0003]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **J. Reece Roth.** Industrial Plasma Engineering. *Principles, Inst. of Physics Publishing*, 1995, vol. 1, 382-385404-407464f [0013]